This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Retrieved Record:

=> d 113 bib ab gi 1

L13 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 1998 DERWENT INFORMATION LTD AN 93-140347 [17] WPIDS

DNC C93-062772

TI New 2-(2-(sulphamoyl alkyl) pyrrolidinyl-thio) carba-penem derivs. - active against resistant Gram negative and positive bacteria, are stable to beta-lactamase and DHP-I.

DC B02

PA (BANY) BANYU PHARM CO LTD

CYC 1

PI JP 05078360 A 930330 (9317)* 41 pp <--ADT JP 05078360 A ***JP 92-42435 920131*** PRAI ***JP 91-31560 910131***

AB JP05078360 A: UPAB: 931025

2-(2-(Sulphamoylalkyl) pyrrolidinylthio) carbapenem deriv. of formula (I), their pharmaceutically acceptable salts and the esters are new. In (I), R1 = H or methyl; R2 = H or negative electric charge; m=0-4; A = -N(R3)R4(R3 and R4 = H, lower alkyl, lower alkenyl, lower alkynyl, -(CH2)n-N(R5)R6(R5 and R6 = H or lower alkyl, n = 1-3), or -(CH2)n-N+ (R7)(R8)R9(R7, R8 and R9 = lower alkyl); or R3 and R4 may together form -(CH2)p- (p=2-5)), or gp. (i) (B=O, S sulphinyl, sulphonyl, -N(R10)-(R10 = lower alkyl opt. substd. by carboxyl, carbamoyl, di-(lower alkyl)-carbamoyl, (lower alkoxy)-carbonyl, cyano, amino, di-(lower alkyl)-amino or OH; H; lower alkenyl; lower alkynyl; lower alkanoyl; carbamoyl; di-(lower alkyl)-carbamoyl; or (lower alkoxy)-carbonyl), or -N+ (R11)(R12)-(R11 = lower alkyl, R12 = lower alkyl opt. substd. bycarboxyl, carbamoyl, di-(lower alkyl)-carbamoyl, (lower alkoxy)-carbonyl, cyano, amino, di-(lower alkyl)-amino or OH, lower alkenyl or lower alkynyl)).

(I) is prepd. by reacting a cpd. of formula (II) or the deriv. with a cpd. of formula (III), opt. followed by deprotection.

USE/ADVANTAGE - (I) exhibits antibacterial activities against sensitive or resistant Gram-positive and Gram-negative bacteria. (I) is stable to beta-lactamase and DHP-I.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-78360

(43)公開日 平成5年(1993)3月30日

(51) Int.Cl.³ 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所 C 0 7 D 477/00 A 6 1 K 31/40 A D Z 7252-4 C 7019-4 C C 0 7 D 487/04 1 3 4

審査請求 未請求 請求項の数8(全 41 百

(21)出願番号	特願平4-42435	(71)出願人	000005072
(22)出願日	平成4年(1992)1月31日	(72)発明者	萬有製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁目2番3号
(31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特願平3-31560 平3 (1991) 1月31日 をユン	(12)元 · 有	中川 晋 愛知県岡崎市上六名3丁目9番地1 萬有 製薬株式会社岡崎研究所内
(33) 医尤惟王張国	日本 (JP)	(72)発明者	中野 文雄 愛知県岡崎市上六名3丁目9番地1 萬有
		(72)発明者	製薬株式会社岡崎研究所内 小野 純
			愛知県岡崎市上六名3丁目9番地1 萬有 製薬株式会社岡崎研究所内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 2- [2-(スルフアモイルアルキル) ピロリジニルチオ] カルパペネム誘導体

(57)【要約】 (修正有) 【構成】 下記式 [I]

OH RI

COOR2 N (CH2) - SO2 - A [I]

(式中、R¹は水素原子またはメチル基、R²は水素原子または陰電荷、mは0ないし4の整数、Aは式-N(R³) R⁴(式中、R³およびR⁴は水素原子、低級アルキル基などを示す)で表される基を示す)で表される化合物またはその医薬として許容される塩またはエステル、その製造法およびその用途。

【効果】 上記の化合物は、新規化合物であり、感受性・耐性のグラム陽性菌およびグラム陰性菌に対する強い 抗菌力、β-ラクタマーゼおよびDHP-Iに対する優れた安定性を有するので、抗菌剤として有用である。 【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式

*【化1】

[式中、R1は水素原子またはメチル基、R2は水素原子 または陰電荷、mは0ないし4の整数、Aは式:-N (R³) R⁴ (式中、R³およびR⁴は同一または異なっ て、水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低 級アルキニル基、式:− (CH₂) ₄ − N (R⁵) R⁵ (式 中、R⁵およびR⁶は同一または異なって、水素原子また は低級アルキル基、nは1ないし3の整数を示す)で表 される基、式: - (CH_{2).} - N · (R') (R³) R 9 (式中、R⁷、R⁸およびR⁹は同一または異なって、低 級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する)で表さ れる基または該低級アルキル基が互いに結合して式:-(CH₂),-(式中、pは2ないし5の整数を示す)で 20 表される基を示す)で表される基または式: 【化21

1

(式中、Bは酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、ス ルホニル基、式:-N (R10) - (式中、R12はカルボ キシル基、カルパモイル基、ジ低級アルキルカルバモイ ル基、低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ り選ばれる置換基を有していてもよい低級アルキル基、 水素原子、低級アルケニル基、低級アルキニル基、低級 アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカル パモイル基または低級アルコキシカルポニル基を示す) で表される基または式:-N * (R ^{เ 1}) (R ^{เ 2}) -(式 中、R¹¹は低級アルキル基、R¹²はカルポキシル基、カ ルパモイル基、ジ低級アルキルカルパモイル基、低級ア ルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基および水酸基からなる群より選ばれる置 換基を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニ 40 ル基または低級アルキニル基を示す)で表される基を示 す」で表される基を示す」で表される化合物またはその 医薬として許容される塩またはエステル。

【請求項2】一般式[Ⅰ]で表される化合物の立体配置 が、(5R, 6S, 8R) または(1R, 5S, 6S, 8 R) である請求項1記載の化合物。

【請求項3】一般式〔Ⅰ〕で表される化合物の2位側鎖 のピロリジン環の立体配置が、(2°S,4°S)また は (2 R, 4 R) である請求項1記載の化合物,

びR'は同一または異なって、水素原子、低級アルキル 基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、式:- (C H₂) - N(R³) R⁶(式中、R³およびR⁶は同一また は異なって、水素原子または低級アルキル基、nは1な いし3の整数を示す)で表される基、式:-(CH2)。 - N° (R') (R°) R° (式中、R'、R°およびR°は 同一または異なって、低級アルキル基を示し、nは前記 の意味を有する)で表される基または該低級アルキル基 が互いに結合して式:- (CH2)。- (式中、pは2な いし5の整数を示す)で表される基を示す]で表される 基である請求項1記載の化合物。

2

【請求項 5】 Aが、-NH₂、-NHCH₁、-NH-(CH₂)₂-NHCH₃または [化3]

$$-N$$
 h

である請求項1記載の化合物。

【請求項6】(5 R.6S)-6- [(R)-1-ヒド ロキシエテル] - 2 - [(2S, 4S) - 2 - スルファ モイルメテルピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバ 基、ジ低級アルキルアミノ基および水酸基からなる群よ 30 ペン-2-エム-3-カルボン酸、(1 R, 5 S, 6 S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メ テル-2- [(2S. 4S) -2-スルファモイルメチ ルピコリジンー4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸、(5R, 6S)-6-[(R) -1 - ヒドロキシエチル] -2 - [(2S, 4S) - 2 - (N-メチルスルファモイルメチル) ピロリジン-4 -イルテオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボ ン鼓、 (1R, 5S, 6S) -6- [(R) -1-ヒド コキシエチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -**2- (N-メチルスルファモイルメチル) ピロリジン-**4-イルテオ]-1-カルバペン-2-エム-3-カル ポン酸、 (5 R, 6 S) - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキ シエテル] -2- [(2S, 4S) -2- [N- [2-(ドーメテルアミノ) エチル] スルファモイルメチル] ピロリジン-4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エ ム-3-カルポン酸、(1R、5S,6S)-6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[$(2S, 4S) - 2 - [N - [2 - (N - \cancel{1} + \cancel{1})] \times [N - [N - N]]$ **ノ)ニテル]スルファモイルメチル]ピロリジン-4-**【請求項4】Aが式:- $ar{\mathrm{N}}$ ($\mathsf{R}^\mathtt{i}$) $\mathsf{R}^\mathtt{i}$ [式中、 $\mathsf{R}^\mathtt{i}$ およ $\mathit{50}$ イルチオ〕-1-カルパペン-2-エム-3-カルポン

【請求項7】一般式

【化4】

[式中、R¹ は水素原子またはメチル基、R¹³ は水素原子または水酸基の保護基、R²⁰ は水素原子またはカルボキシル基の保護基を示す]で表される化合物またはその反応性誘導体と一般式

【化5】

HS
$$(CH_2)_{\overline{m}} SO_2 - A^1$$
 [III]

[式中、 R^{11} は水素原子またはイミノ基の保護基、mは 0 ないし4 の整数、 A^{1} は式:-N (R^{30}) R^{40} (式 中、 R^{30} および R^{40} は同一または異なって、水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基、アミノ基もしくはイミノ基の保護基、式:- (CH_{2}) $_{4}$ $_{4}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$

基もしくはイミノ基の保護基、nは1ないし3の整数を示す)で表される基、式:-(CH2)。-N(R*)(R*)R*(式中、R*, R*およびR*は同一または異なって、低級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する)で表される基または該低級アルキル基が互いに結合して式:-(CH2)。-(式中、pは2ないし5の整数を示す)で表される基を示す}で表される基または式: 【化6】

10 -N B

{式中、B¹は酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、 スルホニル基、式:-N(R¹⁰⁰)-(式中、R¹⁰⁰は保・ 護されていてもよいカルボキシル基、カルバモイル基、 ジ低級アルキルカルバモイル基、低級アルコキシカルボ ニル基、シアノ基、保護されていてもよいアミノ基、ジ 低級アルキルアミノ基および保護されていてもよい水酸 基からなる群より選ばれる置換基を有していてもよい低 級アルキル基、水素原子、低級アルケニル基、低級アル 20 キニル基、低級アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低 級アルキルカルバモイル基、低級アルコキシカルボニル 基またはイミノ基の保護基を示す)で表される基または 式:-N-(R¹¹) (R¹²⁰) - (式中、R¹¹は低級アル キル基、R120は保護されていてもよいカルポキシル 基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、 低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、保護されてい てもよいアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基および保護 されていてもよい水酸基からなる群より選ばれる置換基 を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニル基 30 または低級アルキニル基を示す)で表される基を示す} で表される基を示す]で表される化合物とを反応させ て、一般式

【化7】

$$OR^{13} \qquad R^{1}$$

$$OR^{13} \qquad$$

[式中、 R^1 、 R^{13} 、 R^{14} 、 R^{14} 、 R^{14} およびmは前記の意味を有する]で表される化合物とし、要すれば、一般式 [IV] の化合物の保護基を除去することを特徴とす

る、一安式 【化8】

$$\begin{array}{c} OH \\ \\ O \\$$

「式中、R²は水素原子または陰重荷、Aは式:-N (R¹) R¹ {式中、R¹およびR¹は同一または異なっ て、水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低 級アルキニル基、式:-(C Hz)』-N(R^s) R^g(式 中、R⁵およびR⁶は同一または異なって、水素原子また は低級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する)で 表される基、式:- (CH₂) - N* (R⁷) (R⁸) R⁹ (式中、R⁷、R⁸、R⁹およびnは前記の意味を有す る) で表される基または該低級アルキル基が互いに結合 を示す)で表される基を示す)で表される基または式: 【化9】

{式中、Bは酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、ス ルホニル基、式:-N(R¹⁰)-(式中、R¹⁰はカルボ キシル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイ*

> OH [I] $(CH_2)_m - SO_2 - A$ COOR2

[式中、R¹は水素原子またはメチル基、R²は水素原子 または陰電荷、mは0ないし4の整数、Aは式:-N (R³) R¹ (式中、R³およびR¹は同一または異なっ て、水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低 級アルキニル基、式:-(CH₂)。-N(R⁵)R⁶(式 中、R⁵およびR⁶は同一または異なって、水素原子また は低級アルキル基、nは1ないし3の整数を示す)で表 される基、式: - (CH₂) - N (R⁷) (R⁸) R %(式中、R7、R3およびR%は同一または異なって、低 級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する)で表さ れる基または該低級アルキル基が互いに結合して式:-(CH₂)。- (式中、pは2ないし5の整数を示す)で 表される基を示す)で表される基または式:

【化11】

(式中、Bは酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、ス ルホニル基、式:-N(R¹⁰)-(式中、R¹⁰はカルポ キシル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイ ル基、低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基および水酸基からなる群よ り選ばれる置換基を有していてもよい低級アルキル基、 水素原子、低級アルケニル基、低級アルキニル基、低級 アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカル パモイル基または低級アルコキシカルポニル基を示すと

*ル基、低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基および水酸基からなる群よ り選ばれる置換基を有していてもよい低級アルキル基、 水素原子、低級アルケニル基、低級アルキニル基、低級 アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカル バモイル基または低級アルコキシカルポニル基を示す) で表される基または式:-N・(R**) (R**) - (式 中、Rいは低級アルキル基、Rいはカルポキシル基、カ ルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、低級ア して式:- (CH₂)。- (式中、pは2ないし5の整数 10 ルコキシカルボニル基、シアノ基、アミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基および水酸基からなる群より選ばれる置 **溴基を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニ** ル基または低級アルキニル基を示す) で表される基を示 す】で表される基を示し、R¹およびmは前記の意味を 有する〕で表される化合物またはその医薬として許容さ れる塩またはエステルの製造法。

【請求項8】一般式

【化10】

で表される基または式:-N・(R**) -(式 中、RIIは低級アルキル基、RIIはカルポキシル基、カ ルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、低級ア ルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基および水酸基からなる群より選ばれる置 **| 換基を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニ** ル基または低級アルキニル基を示す) で表される基を示 す)で表される基を示す]で表される化合物またはその 医薬として許容される塩またはエステルを有効成分とす る抗菌剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規なカルバペネム (7-オキソー1-アザビシクロ[3.2.0] ヘプタ - 2 - エン - 2 - カルボン酸) 化合物、該化合物を有効 40 成分として含有する抗菌剤および該化合物の製造方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】近年、ペニシリン類およびセファロスポ リン類と同じる一ラクタム環を持ちながら、これらと基 本骨格の異なった新規なβーラクタム抗生物質が次々と 天然から発見されている。

【0003】例えばストレプトミセス カトレア (St reptomyces cattleya) の醗酵より 単離されたテエナマイシン (thienamycin) 【ジャーナル オブ ジ アメリカン ケミカル ソサ

エティ (丿. Am. Chem. Soc.)、第1 00巻、6491頁(1978年)]のような天然由来 のカルパペネム化合物が挙げられる。 チエナマイシン は、グラム陽性菌およびグラム陰性菌に対して、広範囲 にわたり優れた抗菌スペクトルと強い抗菌力を有するの で、有用性の高い β - ラクタム剤としての開発が期待さ れた。しかしながら、チエナマイシンそのものが化学的 に不安定であり、またある種の生体内酵素、例えば腎デ ヒドロペプチダーゼ I (以下、DHP-Iと略す) によ り分解されて、その抗菌活性の効力を減じ、尿中回収率 10 が低いことが報告されている [アンチミクロピアル ア ジェント アンド ケモテラピィ (Antimicro b. Agents Chemother.)、第22 巻、62頁(1982年);同、第23巻、300頁 (1983年)]。

【0004】メルク(Merck)社では、チエナマイシンの優れた抗菌活性を維持し、且つ、その化学的安定性の確保を狙って、数多くのチエナマイシン類縁体を合成した。その結果、チエナマイシンのアミノ基をホルムイミドイル化したイミペネム(imipenem)[ジ 20ャーナル オブ メディシナル ケミストリィ(J. Med. Chem.)、第22巻、1435頁(1979年)]が医薬品としての実用化に至った。

【0005】イミペネムは、種々の菌種に対してチェナマイシンと同程度以上の抗菌活性およびβーラクタマーゼ抵抗性を保持し、特に緑膿菌に対しては、その抗菌作用が2~4倍優れている。また、イミペネムの水溶液および固体としての安定性は、チェナマイシンに較べ著しく改善された。

【0006】しかしながら、イミペネムはチエナマイシン同様、人の腎臓でDHP-Iにより分解されるため、尿路感染症に使用できないだけでなく、分解産物による腎毒性を示す。そのためにイミペネムは、単独で投与することができず、シラスタチン(cilastatin)のようなDHP-I阻害剤と併用しなければならない[ジャーナル オブ アンチミクロピアル ケモテラピィ(J. Antimicrob. Chemother.)、第12巻(Suppl D)、1頁(1983年)】。また、近年、イミペネムは感染症の治療および予防に頻繁に使用され、イミペネムに耐性なメチシリン高度耐性黄色ブドウ球菌やイミペネム耐性緑膿菌が臨床の場で増加しつつあり、これら耐性菌にイミペネムは充分な治療効果を示していない。

【0007】本発明に最も類似する先行技術としては、 特公昭63-55514号公報があげられる。該公報に は、メロペネム(meropenem; SM-733 8) を代表化合物とする、カルバペネム核の2位に2-(アミノカルボニルまたはN-モノもしくはN, N-ジ低級アルキルアミノカルボニル) ピロリジン-4-イルチオ基を有するカルバペネム化合物が記載されている。 【0008】

【発明が解決しようとする課題】 β - ラクタム抗生物質は、細菌にのみ選択毒性を示し、動物細胞に対しては影響を与えないことから、副作用の少ない抗生物質として細菌による感染症の治療に広く使用され、有用性の高い薬剤である。

【0009】しかしながら、近年、メチシリン高度耐性 黄色プドウ球菌および耐性緑膿菌が免疫力の低下した患 者から難治性の感染症の起炎菌として、しばしば分離され、臨床上大きな問題になりつつある。従って、これら の耐性菌に対する改善された抗菌力を有する抗菌剤の開 発、特にカルパペネム化合物においては、抗菌力の改 善、DHP-Iに対する安定性の改善、腎毒性の軽減、 中枢神経系に対する副作用の軽減等が強く望まれている。

20 【0010】また特公昭63-55514号公報に記載された化合物、特にメロペネムはDHP-Iに対する安定性が大幅に改善された。しかしながら、前記のメチシリン高度耐性黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性は充分ではなく、より優れた抗菌活性を有するカルバペネム化合物が求められている。

【0011】本発明の特徴であるカルバペネム骨格の2位に2-(スルファモイルまたはスルファモイル低級アルキル)ピロリジン-4-イルチオ基を有するカルバペネム化合物は、文献未記載の新規な化合物であり、文献および特許出願明細書において、全く開示されておらず、また示唆すらされていない。

 $\{0012\}$

【課題を解決するための手段】本発明者等は、特にメチシリン高度耐性黄色ブドウ球菌に対して優れた抗菌力を有し、且つDHP-Iに耐性の新規なカルバペネム化合物を提供することを目的とし、鋭意研究した。その結果、カルパペネム骨格の2位に2-(スルファモイルまたはスルファモイル低級アルキル)ピロリジン-4-イルチオ基を有する新規なカルパペネム化合物が、黄色ブドウ球菌等のグラム陽性菌、緑膿菌を含むグラム陰性菌等に対して、強い抗菌力を有し、更にDHP-Iに対しても優れた安定性を示すことを見出し、本発明を完成した

【0013】本発明は、一般式

[0014]

【化12】

[式中、R¹は水素原子またはメチル基、R²は水素原子 または陰電荷、mは0ないし4の整数、Aは式:-N (R³) R¹ {式中、R³およびR¹は同一または異なっ て、水素原子、低級アルキル基、低級アルケニル基、低 10 級アルキニル基、式: - (CH₂) - N (R⁵) R⁶ (式 中、R⁵およびR⁶は同一または異なって、水素原子また は低級アルキル基、nは1ないし3の整数を示す)で表 される基、式:-(CH₂)₄-N^{*}(R⁷)(R⁸)R 9 (式中、R1、R8およびR9は同一または異なって、低 級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する)で表さ れる基または該低級アルキル基が互いに結合して式:-(CH₂)。- (式中、pは2ないし5の整数を示す)で 表される基を示す とで表される基または式:

[0015] 【化13】

{式中、Bは酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、ス ルホニル基、式:-N(R¹⁰)-(式中、R¹⁰はカルポ キシル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイ ル基、低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基および水酸基からなる群よ り選ばれる置換基を有していてもよい低級アルキル基、 水素原子、低級アルケニル基、低級アルキニル基、低級 アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカル バモイル基または低級アルコキシカルポニル基を示す) で表される基または式:-N*(R**)-(式 中、RIIは低級アルキル基、RIIはカルボキシル基、カ ルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、低級ア ルコキシカルボニル基、シアノ基、アミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基および水酸基からなる群より選ばれる置 換基を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニ ル基または低級アルキニル基を示す)で表される基を示 40 す》で表される基を示す]で表される化合物またはその 医薬として許容される塩またはエステル、その製造法お よびその用途に関するものである。

【0016】本明細書に記載された記号および用語につ いて説明する。

【0017】本発明の化合物は、基本構造 [0018]

$$\begin{pmatrix}
(\text{K } 1 \text{ 4}) \\
0 \\
7 \\
1 \\
2 \\
COOH$$

を有し、系統的に7-オキソー1-アザビシクロ[3. 2. 0] ヘプター2-エン-2-カルポン 酸と呼ばれ る。本明細書では、簡易化のために慣用的に広く使用さ れるカルパペネムに基づく番号を付し、その基本構造を 1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸と記載す る。

20 [0019] 【化15】

30

本発明は、カルバペネム骨格の1位、5位、6位および 8位の不斉炭素原子に基づく光学異性体および立体異性 体を包含するが、これら異性体で好適な化合物は、チエ ナマイシンのような立体配置を有する5尺、6 S配置 (5,6-トランス)で、且つ8位の炭素原子がR配置 の化合物である(5R, 6S, 8R)配置の化合物、ま たは1位にメデル基を有する場合は (1R. 5S. 6) S, 8R) 配置の化合物を挙げることができる。

【0020】2位側鎖の2、- (スルファモイルまたは スルファモイル低級アルキル) ピロリジン-4'-イル チオ基についても、ピロリジン核の2位および4位の不 斉炭素に基づく異性体を包含するが、これら異性体で好 適な化合物は (2 'S, 4 'S) 配置および (2 'R, 4'R)配置の化合物を挙げることができる。

【0021】従って、一般式[[]の化合物中、好適な 立体配置を有する化合物群は、一般式

[0022]

【化16]-

OH H
$$\frac{12}{8 \cdot 6}$$
 $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}$

[式中、R¹、R²、Aおよびmは前記の意味を有する] で表される化合物である。

【0023】低級アルキル基とは、直鎖状または分岐状 の炭素数1ないし6個、好適には炭素数1ないし4個か らなるアルキル基を意味し、特にメチル基、エチル基、 tertープチル基等が好適である。

【0024】低級アルケニル基とは、直鎖状または分岐 状の炭素数2ないし6個、好適には炭素数2ないし4個 からなるアルケニル基を意味し、特にアリル基等が好適 である。

【0025】低級アルキニル基とは、直鎖状または分岐 状の炭素数2ないし6個、好適には炭素数2ないし4個 からなるアルキニル基を意味し、特にプロパルギル基等 が好適である。

【0026】低級アルカノイル基とは、直鎖状または分 岐状の炭素数1ないし6個、好適には炭素数1ないし4 個からなるアルカノイル基を意味し、特にホルミル基、 アセチル基等が好適である。

【0027】低級アルコキシカルポニル基とは、前記の 低級アルキル基が置換するオキシ基が置換したカルポニ ル基を意味し、好適には炭素数2ないし5個からなるア ルコキシカルポニル基が挙げられ、特にメトキシカルボ ニル基、エトキシカルポニル基等が好適である。

【0028】ジ低級アルキルカルバモイル基とは、前記 30 の低級アルキル基がジ置換したカルバモイル基を意味 し、好適には炭素数3ないし7個からなるジ低級アルキ ルカルバモイル基が挙げられ、特にジメチルカルバモイ ル基、ジエチルカルバモイル基等が好適である。

【0029】ジ低級アルキルアミノ基とは、前記の低級 アルキル基がジ置換したアミノ基を意味し、好適には炭 素数2ないし6個からなるジ低級アルキルアミノ基が挙 げられ、特にジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基等が 好適である。

【0030】カルボキシル基の保護基としては、例えば 40 メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、t ert-プチル基等の低級アルキル基:例えば2.2. 2-トリクロロエチル基、2, 2, 2-トリフルオロエ チル基等のハロ置換低級アルキル基:例えばアセトキシ メチル基、プロピオニルオキシメチル基、ピバロイルオ キシメチル基、1-アセトキシエチル基、1-プロピオ ニルオキシエチル基等の低級アルカノイルオキシアルキ ル基:例えば1-(メトキシカルポニルオキシ) エチル 基、1-(エトキシカルポニルオキシ)エチル基、1-(イソプロポキシカルボニルオキシ) エチル基等の低級 50

アルコキシカルボニルオキシアルキル基;例えば2-プ ロペニル基、2-クロロ-2-プロペニル基、3-メト キシカルポニルー2-プロペニル基、2-メチルー2-プロペニル基、2-プテニル基、シンナミル基等の低級 アルケニル基:例えばベンジル基、p-メトキシベンジ ル基、3、4 - ジメトキシペンジル基、o - ニトロペン ジル基、p-二トロペンジル基、ペンズヒドリル基、ビ ス(p-メトキシフェニル)メチル基等のアラルキル 基;例えば(5-メチル-2-オキソー1、3-ジオキ ソールー4-イル)メチル基等の(5-置換-2-オキ ソー1, 3-ジオキソールー4-イル)メチル基:例え ばトリメテルシリル基、tert-ブチルジメチルシリ ル基等の低級アルキルシリル基:インダニル基、フタリ ジル基、メトキシメチル基等が挙げられ、特に2-プロ ペニル基、p-ニトロペンジル基、p-メトキシペンジ ル基、ペンズヒドリル基、tert‐プチルジメチルシ リル基等が好ましい。

【0031】水酸基の保護基としては、例えばトリメチ ルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル基等の低 **級アルキルシリル基:例えばメトキシメチル基、2-メ** トキシエトキシメテル基等の低級アルコキシメチル基; 例えばテトラヒドロピラニル基:例えばペンジル基、p -メトキシベンジル基、2、4-ジメトキシベンジル 基、o-二トロペンジル基、p-二トロペンジル基、ト リチル基等のアラルキル基:例えばホルミル基、アセチ ル基等のアシル基;例えばtert‐プトキシカルポニ ル基、2-ヨードエトキシカルポニル基、2、2、2-トリクロロエトキシカルポニル基等の低級アルコキシカ ルボニル基:例えば2-プロペニルオキシカルボニル 基、2-クロロ-2-プロペニルオキシカルボニル基、 3-メトキシカルボニル-2-プロペニルオキシカルボ ニル基、2-メテル-2-プロペニルオキシカルポニル 基、2-プテニルオキシカルポニル基、シンナミルオキ シカルポニル基等のアルケニルオキシカルポニル基;例 えばペンジルオキシカルポニル基、p-メトキシペンジ ルオキシカルポニル基、o-二トロペンジルオキシカル ポニル基、p-ニトロペンジルオキシカルポニル基等の アラルキルオキシカルポニル基等が挙げられ、特に2-プロペニルオキシカルポニル基、p-二トロペンジルオ キシカルポニル基、tert-プチルジメチルシリル基 等が好ましい。

【0032】アミノ基またはイミノ基の保護基として は、例えばペンジリデン基、p-クロロペンジリデン 基、p-二トロペンジリデン基、サリチリデン基、α-

ナフチリデン基、β-ナフチリデン基等のアラルキリデ ン基;例えばペンジル基、p-メトキシベンジル基、 3. 4 - ジメトキシペンジル 基、o - 二トロペンジル 基、p-二トロペンジル基、ペンズヒドリル基、ピス (p-メトキシフェニル) メチル基、トリテル基等のア ラルキル基;例えばホルミル基、アセチル基、プロピオ ニル基、プチリル基、オキサリル基、スクシニル基、ピ パロイル基等の低級アルカノイル基;例えばクロロアセ チル基、ジクロロアセチル基、トリクロロアセチル基、 トリフルオロアセチル基等のハロ置換低級アルカノイル 10 基:例えばフェニルアセチル基、フェノキシアセチル基 等のアリールアルカノイル基:例えばメトキシカルボニ ル基、エトキシカルポニル基、プロポキシカルポニル 基、tert-プトキシカルボニル基等の低級アルコキ シカルポニル基:例えば2-ヨードエトキシカルポニル 基、2、2、2-トリクロロエトキシカルポニル基等の ハロ置換低級アルコキシカルボニル基:例えば2-プロ ペニルオキシカルポニル基、2-クロロ-2-プロペニ ルオキシカルポニル基、3-メトキシカルポニル-2-プロペニルオキシカルボニル基、2-メチル-2-プロ 20 ペニルオキシカルポニル基、2-ブテニルオキシカルボ ニル基、シンナミルオキシカルボニル基等のアルケニル オキシカルポニル基:例えばベンジルオキシカルボニル 基、o-二トロペンジルオキシカルポニル基、p-二ト ロベンジルオキシカルポニル基、フェネチルオキシカル ポニル基等のアラルキルオキシカルポニル基:例えばト リメチルシリル基、tert-プチルジメチルシリル基 等の低級アルキルシリル基等が挙げられ、特に、2-プ ロペニルオキシカルボニル基、tert‐ブトキシカル ポニル基、p-ニトロペンジルオキシカルボニル基等が 30 好ましい。

【0033】一般式 [I] の化合物のピロリジン環の2位側鎖は、式: $-(CH_2)$ $-SO_2-A$ [式中、mは0ないし4の整数、Aは式: $-N(R^3)$ R $-(CH_2)$ $-SO_2-A$ [式中、R $-(CH_2)$ $-(CH_2)$ -

[0034] [化17]

{式中、Bは酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、ス ルホニル基、式:-N(R¹⁰)-(式中、R¹⁰はカルポ キシル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルパモイ ル基、低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基および水酸基からなる群よ り選ばれる置換基を有していてもよい低級アルキル基、 水素原子、低級アルケニル基、低級アルキニル基、低級 アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカル パモイル基または低級アルコキシカルポニル基を示す) で表される基または式:-N・(R**)-(式 中、RII は低級アルキル基、RII はカルボキシル基、カ ルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル基、低級ア ルコキシカルポニル基、シアノ基、アミノ基、ジ低級ア ルキルアミノ基および水酸基からなる群より選ばれる置 換基を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニ ル基または低級アルキニル基を示す)で表される基を示 す」で表される基を示す」で表される。

【0035】該2位側鎖の好適な例としては、式: 【0036】

【化18】

$$-(CH_2)_{\pi}-SO_2-N_{R^4}$$

[式中、R1、R1およびmは前記の意味を有する]で表 される基が挙げられ、例えばスルファモイルメチル基、 スルファモイルエチル基、スルファモイルプロピル基、 N-メテルスルファモイルメチル基、N-メチルスルフ ァモイルエテル基、N-メチルスルファモイルプロピル 基、N-エテルスルファモイルメチル基、N-エチルス ルファモイルエチル基、N-エチルスルファモイルプロ ピル基、N-プロピルスルファモイルメチル基、N-プ ロピルスルファモイルエチル基、N-プロピルスルファ モイルプロピル基、N、N-ジメチルスルファモイルメ チル基、N,N-ジメチルスルファモイルエチル 基、 N、N-ジメチルスルファモイルプロピル基、N-(ア ミノエチル)スルファモイルメチル基、N-(N-メチ ルアミノエテル)スルファモイルメチル基、N-(N. N-ジメテルアミノエチル) スルファモイルメチル基、 N-(1-ピロリジニルエチル)スルファモイルメチル 基、N- (N, N, N-トリメチルアンモニオエチル) スルファモイルメチル基等が挙げられ、特にスルファモ イルメデル基、スルファモイルエチル基、N、Nージメ チルスルファモイルメチル基、N-(アミノエチル)ス ルファモイルメチル 基、N - (N - メチルアミノエチ ル)スルファモイルメチル基、N-(N, N-ジメチル アミノエテル) スルファモイルメチル基、N - (1 - ピ ロリジニルエチル) スルファモイルメチル基、N-(N, N. N-トリメテルアンモニオエチル) スルファ モイルメテル基等が好適である。

50 【0037】また、式:

[0038] [化19]

で表される基のうち、好適な例としては、 (1-ピペラジニル) スルホニルメチル基が挙げられる。

【0039】R²は水素原子または陰電荷を示す。一般式[1]の化合物のピロリジン環の2位側鎖が四級アン*

で表される化合物を以下の表に示す。尚、表における略号の意味を以下に示す(R^2 の欄における – は陰電荷を示す)。

Me:メチル基

Et:エチル基

Pr:プロピル基

*モニウム構造を有する場合、R*は陰電荷を示し、該アンモニウムイオンと対をなすことにより、当該化合物は分子内塩を形成する。

16

【0040】一般式 [I] の化合物の具体例を例示する。本発明によって得られる一般式 [I] の化合物の具体例として、一般式

[I-a]

[0041]

【化20]

i P r : イソプロピル基

tBu:tert-プチル基

Ac:アセチル基

[0042]

20 【表1】

No.	R ¹	R ²	m	Α	No.	H,	R ²	n	Α
1	Н	Н	1	NH ₂	17	н	Н	1	N_SO ₂
2	н	Н	1	NHMe	18	н	Н	1	N NH
3	н	н	1	NHEt	19	н	н	1	NMe
4	н	Н	1	NHPr	20	н	н	1	N_NCH2COOH
5	н	н	1	NH (iPr)	21	Н	Н	1	N_NCH2CONH2
6	н	н	1	NH (tBu)	22	н	н	1.	NCH2CONMe2
7	н	н	1	NHCH ₂ CH = CH ₂	23	н	н	1	NCH2CH=CH2
8	Н	Н	1	NHCH ₂ C ≡ CH	24	н	н	1	NCH ₂ C ≡ CH
9	Н	Н	1	NMe ₂	25	н	н	1	NCH2CH2NH2
10	н	н	1	N	26	н	н	1	NCH ₂ CH ₂ NMe ₂
11	н	н	1	N	27	н	н	1	NCH₂CH₂OH
12	Н	Н	1	N	28	н	н	1	NCHO NCHO
13	н	н	1	N .	29	Н	н	1	N_NAc
14	н	н	1	N_0 ,	30	н	н	1	N_NCONH ₂
15	н	н	1	N_s	31	н	н	1	N_NCONMe₂
18	н	Н	1	N_so	32	Н	н	1	N_NCOOMe
							1		

[0043]

【表2】

	^	
,	u	

No.	R ¹	R ²	m	A	No.	R ¹	R ²	m	Α
33	н	Н	1	N_NCOOEt	49	н	Н	2	NH (tBu)
34	н	-	1	N_N_We	50	н	н	2	NHCH ₂ CH = CH ₂
35	н	-	1	N_N < Me CH ₂ COO -	51	н	н	2	NHCH ₂ C ≡ CH
36	н	_	1	N N CH ₂ CONH ₂	52	н	н	2	NMe ₂
37	Н	-	1	N N CH ₂ COOMe	53	н	н	2	N⊲
38	н	-	1	N N Me CH ₂ CN	54	н	н	2	N
39	н	_	1	Me CH 2CH=CH2	55	н	н	2	N
40	н	_	1	$N = N + Me$ $CH_2C = CH$	56	н	н	2	N
41	н		1	N He CH ₂ CH ₂ NH ₂	57	н	н	2	N_0
42	н	-	1	N N CH2CH2NMe2	58	н	н	2	N_s
43	н	-	1	N N CH ₂ CH ₂ OH	59	н	н	2	N_so
44	н	Н	2	NH ₂	60	н	н	2	N_SO ₂
45	н	н	2	NHMe	61	Н	н	2	N_NH
46	н	н	2	NHEt	62	н	н	2	N_NMe
47	н	н	2	NHPr	63	н	н	2	N_NCH2COOH N_NCH2CONH2
48	н	н	2	NH (iPr)	64	н	н	2	N_NCH2CONH2
								\perp	

[0044]

【表3】

_			-					_	22
No.	R ¹	R ²	m	A	No.	R¹	R ²	п	A
65	Н	н	2	NCH ₂ CONMe ₂	81	н	_	2	N N CH₂CN
66	н	н	2	NCH ₂ CH=CH ₂	82	н	-	2	N CH ₂ CH=CH ₂
67	н	н	2	NCH ₂ C ≡ CH	83	Н	_	2	N N Me CH ₂ C ≡ CH
68	Н	н	2	NCH ₂ CH ₂ NH ₂	84	н		2	N CH ₂ CH ₂ NH ₂
69	Н	Н	2	NCH ₂ CH ₂ NMe ₂	85	Н	-	2	N CH ₂ CH ₂ NMe ₂
70	Н	Н	2	N_NCH₂CH₂OH	86	Н	-	2	N CH ₂ CH ₂ OH
71	H	н	2	N_NCHO	87	Мө	н	1	NH ₂
72	Н	Н	2	N_NAc	88	Me	н	1	NHMe
73	н	н	2	N_NCONH2	89	Ме	н	1	NHEt
74	Н	н	2	NCONMe ₂	90	Me	н	1	NHPr
75	н	н	2	NCOOMe	91	Мө	н	1	NH (iPr)
76	н	н	2	N_NCOOEt	92	Me	н	1	NH (tBu)
77	н	-	2	N_N <me< th=""><th>93</th><th>Ме</th><th>н</th><th>1</th><th>NHCH₂CH = CH₂</th></me<>	93	Ме	н	1	NHCH ₂ CH = CH ₂
78	Н	-	2	NCN Me CH ₂ COO-	94	Ме	н	1	NHCH ₂ C ≡ CH
79	н	-	2	N N Me CH ₂ CONH ₂	95	Мө	н	1	NMe ₂
80	н	-	2	N He CH ₂ COOMe	96	Me	н	1	N⊲

[0045]

【表4】

2	•
/	•

_		_	_	Υ	. —	·		_	24
No.	R ¹	R ²	m	A	No.	R ¹	R ²	m	A
97	Ме	Н	1	N	113	Ме	Н	1	NCH2CH2OH
98	Ме	Н	1	N	114	Me	н	1	N_NCHO
99	Мө	н	1	N .	115	Мө	н	1	N_NAc
100	Ме	н	1	N_0	116	Me	н	1	NCONH2
101	Мө	н	1	N_s	117	Ме	Н	1	N_NCONMe ₂
102	Ме	н	1	N_so	118	Me	Н	1	NOOOMe
103	Мө	н	1	N_so ₂	119	Мө	н	1	N_NCOOEt
104	Me	н	1	N NH	120	Me	_	1	√ Ne Me
105	Ме	н	1	N_NMe	121	Мө	-	1	Me CH ₂ COO
106	Ме	Н	1	N_NCH2COOH	122	Me	-	1	Me CH ₂ CONH ₂
107	Мө	Н	1	NCH2CONH2	123	Me	-	1	N Me CH ₂ COOMe
108	Ме	н	1	NCH ₂ CONMe ₂	124	Me	-	1	Me CH ₂ CN
109	Me	н	1	NCH ₂ CH=CH ₂	125	Мө	-	1	CH ₂ CH=CH ₂
110	Ме	Н	1	NCH ₂ C ≡ CH	126	Me	-	1	Me CH ₂ C ≡ CH
111	Мө	н	1	NCH ₂ CH ₂ NH ₂ NCH ₂ CH ₂ NMe ₂	127	Мө	-	1	Me CH ₂ CH ₂ NH ₂
112	Ме	н	1	NCH2CH2NMe2	128	Me	-	1	CH ² CH ² NMe ²
			\perp					\perp	

[0046]

【表 5 】

ac

	2								
No.	R¹	R ²	6	A	No.	R¹	R ²	E	A
129	Me	_	1	↑ Me CH ₂ CH ₂ OH	145	Мө	Н	2	N_so
130	Ме	н	2	NH ₂	146	Ме	н	2	N_SO ₂
131	Me	н	2	NHMe	147	Мө	Н	2	и∭ин
132	Ме	Н	2	NHEt	148	Me	Н	2	N_NMe
133	Мө	Н	2	NHPr	149	Мө	Н	2	NCH2COOH
134	Ме	Н	2	NH (iPr)	150	Me	Н	2	NCH2CONH2
135	Мө	н	2	NH (tBu)	151	Me	Н	2	NCH ₂ CONMe ₂
136	Me	н	2	NHCH ₂ CH = CH ₂	152	Me	Н	2	NCH ₂ CH=CH ₂
137	Мө	Н	2	NHCH ₂ C ≡ CH ₂	153	Ме	н	2	NCH2C ≡ CH
138	Me	н	2	NMe ₂	154	Me	Н	2	NCH2CH2NH2
139	Мө	н	2	\bowtie	155	Мө	н	2	NCH ₂ CH ₂ NMe ₂
140	Me	н	2	N	156	Me	н	2	NCH2CH2OH
141	Мө	Н	2	N	157	Me	н	2	√ исно
142	Me	н	2	\sim	158	Me	н	2	N_NAc
143	Мө	Н	2	√ 0	159	Mə	н	2	N_NCONH2
144	Me	н	2	N_s	160	Me	н	2	N_NCONMe ₂
	:								

[0047]

【表6】

		27	7					•	28
No.	R ¹	R ²	n	A	No.	R¹	R ²	m	A
161	Ме	Н	2	N_NCOOMe	177	Н	н	3	M
162	Ме	Н	2	N_NCOOEt	178	н	Н	3	\sim
163	Мө	_	2	N Me	179	н	н	3	N
164	Ме	-	2	NON CH2COO-	180	н	н	3	N_NH
165	Мө	-	2	NON Me CH ₂ CONH ₂	181	н	Н	3	NCH2COOH
166	Ме	_	2	NON CH2COOMS	182	н	н	3	NONCH2CONH2
167	Мө	_	2	NCN Me CH₂CN	183	н	н	3	NCH ₂ CH=CH ₂
168	Ме	_	2	N He CH ₂ CH=CH ₂	184	Н	н	3	N_NCH ₂ C ≡ CH
169	Мө	-	2	$N = N + Me$ $CH_2C = CH$	185	н	н	3	N_NCH2CH2NH2
170	Me	-	2	NCN Me CH2CH2NH2	186	н	н	3	NCH ₂ CH ₂ OH
171	Мө	-	2	N CH2CH2NMe2	187	н	н	3	NAc NAc
172	Ме		2	N_N CH ₂ CH ₂ OH	188	н	н	3	NCONH ₂
173	н	н	3	NH ₂	189	н	-	3	√ Ne Me
174	н	Н	3	NMe ₂	190	н	-	3	N_N <me ch2conh2<="" td=""></me>
175	н	н	3	NHCH ₂ CH = CH ₂	191	н	-	3	N Me CH ₂ CN
176	н	н	3	NHCH ₂ C ≡ CH	192	н	-	3	NCH ₂ CH=CH ₂

[0048]

【表7】

29									30		
No.	R ¹	R ²	m	A	No.	R¹	R²	m	A		
193	Н	_	3	N He CH ₂ C ≡ CH	209	Ме	Н	3	N_NAc		
194	н	-	3	N N CH ₂ CH ₂ OH	210	Ме	н	3	N_NCONH ₂		
195	Мө	н	3	NH ₂	211	Мө	_	3	N_N_We		
196	Ме	н	3	NMe ₂	212	Me	-	3	NN Me CH ₂ CONH ₂		
197	Мө	н	3	NHCH ₂ CH = CH ₂	213	Мө	_ '	3	NN Me CH ₂ CN		
198	Ме	H	3	NHCH ₂ C ≡ CH	214	Ме	_	3	N He CH ₂ CH=CH ₂		
199	Ме	н	3	\swarrow	215	Мө	_	3	$N = N $ $CH_2C \equiv CH$		
200	Ме	н	3	N\$\triangle \tag{1}	216	Me	-	3	N Me CH ₂ CH ₂ OH		
201	Мө	Н	3	V	217	Н	Н	4	NH ₂		
202	Me	н	3	N_NH	218	н	н	4	NMe ₂		
203	Мө	н	3	N_NCH₂COOH	219	Н	н	4	NHCH ₂ CH = CH ₂		
204	Me	Н	3	N_NCH2CONH2	220	н	Н	4	NHCH ₂ C ≡ CH		
205	Me	Н	3	NCH2CH=CH2	221	Н	н	4	\bowtie		
208	Me	Н	3	N_NCH ₂ C ≡ CH	222	Н	Н	4	N		
207	Me	Н	3	N_NCH2CH2NH2	223	н	Н	4	N		
208	Me	н	3	N_NCH₂CH₂OH	224	Н	н	4	N_NH		

[0049]

【表8】

20	
.5/	
~~	

		7-	_	1	<u> </u>		, _		32
No	. R¹	R²	ı	A	No	. R¹	R ²	m	A
225	5 Н	Н	4	иДисн₂с∞н	241	Me	Н	4	NHCH ₂ CH = CH ₂
226	Н	Н	4	N_NCH2CONH2	242	Ме	Н	4	NHCH ₂ C ≡ CH
227	т н	Н	4	NCH2CH=CH2	243	Мә	н	4	\bowtie
228	н	H	4	N_NCH ₂ C ≡ CH	244	Me	Н	4	N\$
229	Н	Н	4	N_NCH ₂ CH ₂ NH ₂	245	Ме	н	4	ν
230	Н	Н	4	N_NCH₂CH₂OH	246	Me	н	4	N_NH
231	н	Н	4	N_NAc	247	Ме	н	4	N_NCH₂COOH
232	Н	н	4	N_NCONH ₂	248	Me	н	4	N_NCH2CONH2
233	Н	_	4	√ N∈ Me	249	Ме	Н	4	NCH ₂ CH=CH ₂
234	н	_	4	N N Me CH ₂ CONH ₂	250	Me	н	4	NCH ₂ C ≡ CH
235	Н	_	4	N N Me CH ₂ CN	251	Мө	н	4	N_NCH2CH2NH2
236	н	-	4	N N Me CH ₂ CH=CH ₂	252	Me	н	4	NCH ₂ CH ₂ OH
237	H	-	4	NN Me CH ₂ C ≡ CH	253	Мө	н	4	N_NAc
238	Н	-	4	N N CH ₂ CH ₂ OH	254	Ме	н	4	N_NCONH ₂
239	Мө	н	4	NH ₂	255	Мә	-	4	N Me Me
240	Me	Н	4	NMe ₂	256	Ме	-	4	Me N N CH ₂ CONH ₂

[0050]

【表9】

		33							34			
No.	R ¹	R ²	m	A	No.	R¹	R²	m	Α			
257	Мө	_	4	N N CH ₂ CN	273	Н	Н	0	NCH2CH2NH2			
258	Ме	-	4	N N CH ₂ CH=CH ₂	274	н	н	0	NCH2CH2OH			
259	Мө	-	4	N Me CH ₂ C ≡ CH	275	н	Н	0	N_NAc			
260	Me	1	4	NON CH2CH2OH	276	н	н	0	NCONH ₂			
261	н	н	0	NH ₂	277	н	_	0	N Ne Me			
262	н	н	0	NMe ₂	278	н	-	0	N N N CH ₂ CONH ₂			
263	н	H	0	NHCH ₂ CH = CH ₂	279	н	_	0	NCN [†] CH₂CN			
264	н	н	0	NHCH ₂ C ≡ CH	280	н	-	0	N N H CH ₂ CH=CH ₂			
265	н	н	0	abla	281	Н	_	0	Me CH ₂ C ≡ CH			
266	н	Н	0	N	282	Н	_	0	Me CH ₂ CH ₂ OH			
267	н	н	0	N	283	Мө	н	0	NH ₂			
268	н	н	0	v_NH	284	Me	н	0	NMe ₂			
269	Н	Ή	0	NCH2COOH	285	Ме	н	0	NHCH ₂ CH = CH ₂			
270	Н	Н	0	NCH₂CONH₂	286	Me	Н	0	NHCH ₂ C ≡ CH			
271	н	н	0	NCH ₂ CH=CH ₂	287	Me	н	0	\bowtie			
272	Н	н	0	N_NCH ₂ C ≡ CH	288	Me	н	0	\Diamond			
	İ				<u> </u>			1_	<u> </u>			

[0051]

【表10】

No.	R¹	R²	Œ	A	No.	R ¹	R ²	е	A
289	Мө	н	0		305	Me	н	1	NH(CH ₂) ₂ NH ₂
290	Me	Н	0	иСин	306	Ме	Н	1	NH(CH ₂) ₂ NHMe
291	Мө	Н	0	NCH₂COOH	307	Мө	н	1	NH(CH ₂) ₂ NM ₉₂
292	Ме	н	0	N_NCH2CONH2	308	Ме	н	1	NH(CH ₂) ₂ N
293	Мө	Н	0	N_NCH2CH=CH2	309	Ме	<u>-</u>	1	NH(CH ₂) ₂ NM ₉₃
294	Me	н	0	NCH ₂ C ≡ CH	310	Ме	н	2	NH(CH ₂) ₂ NH ₂
295	Мө	Н	0	NCH2CH2NH2	311	Мө	Н	2	NH(CH ₂) ₂ NHMe
296	Ме	Н	0	NCH₂CH₂OH	312	Me	н	2	NH(CH ₂) ₂ NMe ₂
297	Мө	Н	0	N_NAc	313	Мө	н	2	NH(CH2)2N
298	Me	Н	0	N_NCONH₂	314	Me	_	2	NH(CH ₂) ₂ NMe ₃
299	Мө	_	0	N_N Me	315	Me	н	1	NH(CH ₂) ₂ NHMe
300	Me	-	0	N N Me CH ₂ CONH ₂		L	L	<u>l</u>	<u>L</u>
301	Ме	_	0	N N CH ₂ CN					
302	Me	_	0	NN Me CH ₂ CH=CH ₂					
303	Me	_	0	N CH ₂ C ≡ CH					
304	Me	-	0	N CH ₂ CH ₂ OH					

上記の具体的化合物中、特に好適な化合物を下記に示 す。

(5R, 6S) - 6 - [(R) - 1 - EFD + 5 + 5][-2-[(2S, 4S)-2-(ZN)]テル) ピロリジンー4-イルチオ] -1-カルバペンー 2-エム-3-カルポン酸(化合物1)

(5R, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチ ァモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カ ルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物2)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - (N-7)]リルスルファモイルメテル) ピロリジン-4-イルチ オ] -6 - [(R) -1 -ヒドロキシエチル] -1 -カ ルパペンー2-エムー3-カルポン酸(化合物7)

(5R, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチ ル] -2- [(2S, 4S) -2-(N-プロパルギル スルファモイルメテル) ピロリジン-4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物 S)

(5R. 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - (N, N)]50

ージメチルスルファモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物9)(5R, 6S)-2-[(2S, 4S)-2-(1-アジリジニルスルホニルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1-ヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物10)

ルパペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物10) (5 R, 6 S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2 S, 4 S) -2- (1-ピロリジニルスルホニルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物12) (5 R, 6 S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2 S, 4 S) -2- (1-ピペラジニルスルホニルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物18) (5 R, 6 S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2 S, 4 S) -2- [(4-メチル-1-ピペラジニルスルホニル) メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボンイルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン

(5R, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[[4-(カルバモイルメチル) -1-ピペラジニルスルホニ ル] メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物21)

酸(化合物19)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [[4 - (N, N - ジメチルカルバモイルメチル) - 1 - ピペラジニルスルホニル] メチル] ピロリジン - 4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン - 2 - エム - 3 - カルボン酸(化合物 2 2)

(5R, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[(4-アリル-1-ピペラジニルスルホニル) メチル] ピロリ ジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物23)

(5R,6S)-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-2-[(2S,4S)-2-[(4-プロパルギル-1-ピペラジニルスルホニル)メチル]ピロリジン-4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物24)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [(4-カルバモイル-1 - ピペラジニルスルホニル)メチル] ピロリジン-4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物30)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [[4 - (N, N - ジメチルカルバモイル) - 1 - ピペラジニルスルホニル] メチル] ピロリジンー4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパベン - 2 - エム - 3 - カルポン酸 (化合物 <math>3 1)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [(4, 4 - ジメチル - 1 - ピペラジニオスルホニル) メチル] ピロリジン - 4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン - 2 - エム - 3 - カルポキシラート(化合物 3 4)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [(4 - カルバモイルメチル-4 - メチル-1 - ピペラジニオスルホニル) メチル] ピロリジン-4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルバペン-10 2 - エム-3 - カルボキシラート(化合物36)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [(4 - アリル-4 - メチル-1 - ピペラジニオスルホニル) メチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボキシラート(化合物39)

(5 R, 6 S) - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [(4 - メチル - 4 - プロパルギル - 1 - ピペラジニオスルホニル) メチル] ピロリジンー4 - イルチオ] - 1 - カルパペン - 2 - エム - 3 - カルポキシラート(化合物 4 0)

(5R, 6S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2S, 4S) -2- (2-スルファモイルエチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物44)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [2 - (N-アリルスルファモイル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸 (化合物50)

30 (5 R, 6 S) - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [2 - (N - プロバルギルスルファモイル) エチル] ピロリジン-4 - イルチオ] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸(化合物51)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [2 - (N, N - ジメチルスルファモイル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) -1-ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸(化合物5 2)

0 (5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [2 - (1 - アジリジニルスルホニル) エチル] ピロリジンー4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸(化合物53)

(5R, 6S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2S, 4S) -2- [2-(1-ピロリジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物55)

50 (5 R. 6 S)-6-[(R)-1-ヒドロキシエチ

ル] -2- [(2S, 4S) -2- [2-(1-ピペラ ジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチ オ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化 合物61)

(5R, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -2-[(2S, 4S) -2-[2-(4-メチル-1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリジンー4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物62)

(5R, 6S) -2- [(2S, 4S) -2- [2-[4-(カルバモイルメチル) -1-ピペラジニルスル ホニル] エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物64)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [2 - [4 - (N, N - ジメチルカルバモイルメチル) - 1 - ピペラジニルスルホニル] エチル] ピロリジンー4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸(化合物65)

(5R, 6S) -2- [(2S, 4S) -2- [2- (4-アリル-1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物66)

(5R, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -2-[(2S, 4S) -2-[2-(4-プロパルギル-1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物67)

(5R, 6S) -2- [(2S, 4S) -2- [2- (4-カルバモイル-1-ピペラジニルスルホニル) エ チル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1 -ヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3 -カルボン酸(化合物73)

(5R, 6s) -2- [(2S, 4S) -2- [2- [4-(N, N-ジメチルカルバモイル) -1-ピペラジニルスルホニル] エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルバベン-2-エム-3-カルボン酸(化合物74)

(5R, 6S) -2- [(2S, 4S) -2- [2- (4, 4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニル) エテル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-カルバベン-2-エム-3-カルボキシラート(化合物77)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [2 - (4 - カルバモイルメチル - 4 - メチル - 1 - ピベラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン - 4 - イルテオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルバペン - 2 - エム - 3 - カルボキシラート(化合物 79)

40

(5 R. 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [2 - (4 - アリル - 4 - メチル - 1 - ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン - 4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペンー2 - エム - 3 - カルボキシラート(化合物82)

(5 R, 6 S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -2-[(2 S, 4 S) -2-[2-(4-メチル-4-プロバルギル-1-ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-10 2-エム-3-カルボキシラート(化合物83)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-(スルファモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物87)

(1R、5S、6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S、4S) -2-(N-メテルスルファモイルメチル) ピロリジンー4ーイルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン20酸(化合物88)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-(N-アリルスルファモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン 酸(化合物93)

(1R, 5S, 6S) - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシェチル] - 1 - メチル - 2 - [(2S, 4S) - 2 - (N - プロパルギルスルファモイルメチル) ピロリジン - 4 - イルチオ] - 1 - カルバベン - 2 - エム - 3 - カルボン酸(化合物 9 4)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-(N, N-ジメチルスルファモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物95)

(1R、5S、6S) -2- [(2S、4S) -2- (1-アジリジニルスルホニルメチル) ピロリジンー4 -イルテオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルバベン-2-エム-3-カルボ ン酸(化合物96)

(1R. 5S. 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエテル] -1-メチル-2-[(2S. 4S) -2-(1-ピロリジニルスルホニルメチル) ピロリジンー4 -イルテオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化合物98)

(1R. 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエテル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-(1-ピペラジニルスルホニルメチル) ピロリジン-4-イルテオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポ50 ン酸(化合物104)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -2-[(4-メチルー1-ピペラジニルスル ホニル)メチ ル] ピロリジンー4-イルチオ]-1-カルパペン-2 -エム-3-カルポン酸(化合物105)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[[4-(カルパモイルメチル)-1-ピペラジニルス ルホニル] メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルパペンー2-エムー3-カルボン酸(化合物10 7)

(1 R. 5 S. 6 S) - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 -[[4-(N, N-ジメチルカルバモイルメチル) -1-ピペラジニルスルホニル] メチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポン 酸(化合物108)

(1 R. 5 S. 6 S) - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 -〔(4-アリル-1-ピペラジニルスル ホニル)メチ ル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1- 20 ヒドロキシエテル] -1-メチル-1-カルパペン-2 -エム-3-カルボン酸 (化合物109)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-[(4-プロパルギル-1-ピペラジニルスルホニル) メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン -2-エム-3-カルボン酸 (化合物110)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[(4-カルパモイル-1-ピペラジニルスルホニル) メチル] ピロリジン-4 -イルチオ] -6 - [(R)-1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン - 2 - エム - 3 - カルポン酸(化合物 1 1 6)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[[4-(N. N-ジメチルカルバモイル)-1-ピペ ラジニルスルホニル] メチル] ピロリジン-4-イルチ チルー1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化 合物117)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[(4,4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニル) メチル] ピロリジンー4-イルチオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルパペン - 2 - エム - 3 - カルボキシラート(化合物 1 2 0)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[(4-カルバモイルメチル-4-メチル-1-ピペラ ジニオスルホニル) メチル] ピロリジンー4ーイルチ オ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メ チルー1-カルバペン-2-エム-3-カルポキシラー ト(化合物122)

[(4-アリル-4-メチル-1-ピペラジニオスルホ ニル) メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(化合物 125)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -2-[(4-メチル-4-プロパルギル-1-ピペラジニオ スルホニル)メチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1 10 -カルパペン-2-エム-3-カルボキシラート (化合 物126)

(1R. 5S. 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2- [(2S. 4S) -2-(2-スルファモイルエチル) ピロリジン~4-イルチ オ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化 合物130)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[2-(N-アリルスルファモイル) エチル] ピロリジ ン-4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエ チル] -1-メテル-1-カルバベン-2-エム-3-カルポン酸 (化合物136)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45)-2-[2-(N-プロパルギルスルファモイル) エチル] ピ ロリジンー4ーイルチオ] -1-カルパペン-2-エム -3-カルボン酸(化合物137)

(1 R. 5 S. 6 S) - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 -[2-(N. N-ジメチルスルファモイル) エチル] ピ ロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1-ヒドロ 30 キシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム - 3 - カルボン酸 (化合物 1 3 8)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[2-(1-アジリジニルスルホニル) エチル] ピロリ ジン-4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-1-カルバペン-2-エム-3 - カルボン酸 (化合物 139)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -2-[2-(1-ピロリジニルスルホニル) エチル] ピロリ 40 ジン-4-イルチオ]-1-カルバペン-2-エム-3 カルボン酸(化合物141)

(1 R. 5 S. 6 S) -6 - [(R) -1 -ヒドロキシ エチル] - 1 - メチル - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 -[2-(1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリ ジン-4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3 - カルボン酸 (化合物 1 4 7)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -2-[2-(4-メチル-1-ピペラジニルスルホニル) エ (1 R、5 S、6 S) -2-[(2 S, 4 S) -2-50 テル] ピロリジン-4-1ルチオ] -1-カルパペン-

2-エム-3-カルポン酸(化合物148)

(1R, 5S, 6S) -2- [(2S, 4S) -2- [2-[4-(カルバモイルメチル) -1-ピペラジニルスルホニル] エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチルー1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物150)

(1R.5S,6S)-2-[(2S,4S)-2-[2-[4-(N,N-ジメチルカルバモイルメチル) -1-ピペラジニルスルホニル]エチル]ピロリジン- 10 4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物151)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[2-(4-アリル-1-ピペラジニルスルホニル) エ チル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1 -ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物152)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2- 20 [2-(4-プロパルギル-1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物153)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[2-(4-カルバモイル-1-ピペラジニルスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチルー1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物15 9)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[2-[4-(N, N-ジメチルカルバモイル) -1-ピペラジニルスルホニル] エチル] ピロリジン-4-イ ルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエテル] -1 -メチル-1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物 160)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[2-(4, 4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(化合物163)

(1R, 5S, 6S) -2- [(2S, 4S) -2-[2-(4-カルパモイルメチル-4-メチル-1-ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルテオ] -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(化合物165)

(1 R. 5 S. 6 S) - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 - [2 - (4 - アリル - 4 - メチル - 1 - ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - 50

44

[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチルー1-カルパペン-2-エム-3-カルボキシラート (化合物 168)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-[2-(4-メチル-4-プロパルギル-1-ピペラジニオスルホニル) エチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(化合物 169)

(5R,6S)-6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-2-[(2S,4S)-2-(3-スルファモイルプロビル) ピロリジン-4-イルチオ]-1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物173)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [3 - (N, N - ジメチルスルファモイル) プロビル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルパペン-2 - エム-3 - カルボン酸(化合物 1 7 4)

(5R, 6S) -6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -2- [(2S, 4S) -2- [3-(1-ピペラジニルスルホニル) プロピル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物180)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [3 - (4, 4 - ジメチル - 1 - ピペラジニオスルホニル) プロピル] ピロリジン - 4 - イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - カルバベン - 2 - エム - 3 - カルボキシラート(化合物 1 8 9)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ
 30 エチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-(3-スルファモイルプロピル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物195)

(1R, 5S, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [3 - (N, N - ジメチルスルファモイル) プロピル] ピロリジン-4-イルチオ] - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - メチル - 1 - カルバベン - 2 - エム - 3 - カルボン酸(化合物196)

(1R. 5S. 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ 40 エチル] -1-メチル-2-[(2S. 4S) -2-[3-(1-ピペラジニルスルホニル) プロピル] ピロ リジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物202)

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-[3-(4, 4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニル) プロピル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(化合物211)

(5R、6S)-6-[(R)-1-ヒドロキシエチ

 $[\mu]$ - 2 - [(2S, 4S) - 2 - (4 - $[\mu]$ - $[\mu]$ - $[\mu]$ ルプチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバベ ン-2-エム-3-カルポン酸(化合物217)

(5 R, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 - [4 -(N, N-ジメチルスルファモイル) プチル] ピロリジ ン-4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロキシエ チル]-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸 (化合物218)

(5 R, 6 S) - 6 - [(R) - 1 - ヒドロキシエチ ル] -2-[(2S, 4S) -2-[4-(1-ピペラ 10 ジニルスルホニル) プチル] ピロリジン-4-イルチ オ]-1-カルパペン-2-エム-3-カルボン酸(化 合物224)

(5R, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 - [4 -(4、4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニル)ブ チル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1 ーヒドロキシエチル] -1-カルパペン-2-エム-3 -カルポキシラート(化合物233)

エチル] -1-メチル-2-[(25, 45)-2-(4-スルファモイルプチル) ピロリジン-4-イルチ オ]-1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸(化 合物239)

(1 R, 5 S, 6 S) - 2 - [(2 S, 4 S) - 2 -[4-(N, N-ジメチルスルファモイル) プチル] ピ ロリジン-4-イルチオ]-6-[(R)-1-ヒドロ キシエチル] -1-メチル-1-カルバペン-2-エム -3-カルポン酸(化合物240)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-2-[(25, 45)-2-[4-(1-ピペラジニルスルホニル) プチル] ピロリ ジン-4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3 - カルポン酸(化合物246)

(1R, 5S, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 -[4-(4,4-ジメチル-1-ピペラジニオスルホニ ル) プチル] ピロリジン-4-イルチオ] -6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3-カルボキシラート(化合物 255)

(1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] - 1 - メチル - 2 - [(25, 45) - 2 -[N-[2-(N-メチルアミノ) エチル] スルファモ イルメチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバ ペン-2-エム-3-カルボン酸(化合物306)また

(5 R, 6 S) -6 - [(R) -1 -ヒドロキシエチ N = 2 - (2S, 4S) - 2 - (N - (2 - (N -メテルアミノ) エチル] スルファモイルメチル] ピロリ ジンー4-イルチオ]-1-カルパペン-2-エム-3 一カルポン酸(化合物315)の化合物であり、特に 50 ホン酸塩等のスルホン酸塩;例えばアスパラギン酸塩、

(1), (2), (9), (18), (34), (3 6), (44), (52), (61), (77), (7 9), (87), (88), (93), (94), (9 5), (96), (98), (104), (105), (107), (108), (109), (110), (116), (120), (122), (125), (126), (130), (136), (137), (138), (139), (141), (147), (148), (150), (151), (152), (153), (159), (160), (163), (165), (168), (169), (173), (174), (180), (189), (195), (196), (202), (211), (217), (218), (224), (233), (239), (240)、(246)、(255)、(306) また は(315)の化合物が好適である。

46

【0052】一般式[1]の化合物は、常法により医薬 として許容される塩また はエステルとすることができ る。

【0053】一般式[1]の化合物の塩としては、医薬 上許容される慣用的なものを意味し、カルバペネム骨格 の3位のカルボキシル基または2位側鎖部分に置換する カルポキシル基またはピロリジン環上の塩形成可能な窒 素原子(ピロリジン塩基)における塩類を挙げることが

【0054】該カルボキシル基における塩基性付加塩と しては、例えばナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ 金属塩:例えばカルシウム塩、マグネシウム塩等のアル カリ土類金属塩;例えばアンモニウム塩:例えばトリメ 30 チルアミン塩、トリエチルアミン塩、ジシクロヘキシル アミン塩、エタノールアミン塩、ジエタノールアミン 塩、トリエタノールアミン塩、プロカイン塩等の脂肪族 アミン塩;例えばN、N'-ジベンジルエチレンジアミ ン等のアラルキルアミン塩:例えばピリジン塩、ピコリ ン塩、キノリン塩、イソキノリン塩等の複素環芳香族ア ミン塩:例えばテトラメチルアンモニウム塩、テトラエ チルアンモニウム塩、ベンジルトリメチルアンモニウム 塩、ペンジルトリエチルアンモニウム塩、ペンジルトリ プチルアンモニウム塩、メチルトリオクチルアンモニウ 40 ム塩、テトラブチルアンモニウム塩等の第4級アンモニ ウム塩:例えばアルギニン塩、リジン塩等の塩基性アミ ノ酸塩等が挙げられる。

【0055】該ピロリジン塩基における酸付加塩として は、例えば追弦塩、硫酸塩、硝酸塩、りん磁塩、炭酸 塩、炭酸水素塩、過塩素酸塩等の無機酸塩;例えば酢酸 塩、プロピオン酸塩、乳酸塩、マレイン酸塩、フマール 酸塩、酒石豉塩、りんご酸塩、くえん酸塩、アスコルビ ン酸塩等の有機酸塩;例えばメタンスルホン酸塩、イセ チオン酸塩、ペンゼンスルホン酸塩、p-トルエンスル

グルタミン酸塩等の酸性アミノ酸塩等が挙げられる。

【0056】一般式 [I] の無毒性エステルとしては、カルパペネム骨格の3位のカルポキシル基における医薬上許容される慣用的なものを意味する。例えばアセトキシメチル基、ピパロイルオキシメチル基等のアルカノイルオキシメチル基とのエステル、1-(エトキシカルポニルオキシ)エチル基等のアルコキシカルポニルオキシアルキル基とのエステル、フタリジル基とのエステル、(5-メテル-2-オキソー1,3-ジオキソール-4-イル)メチル基等の(5-置換-2-オキソー1,3-ジオキソール-4-イル)メチル基とのエステル等が挙げられる。

【0057】本発明の化合物の製法について説明する。 本発明の一般式[1]の化合物は、一般式

[0058]

【化21】

[式中、R¹は水素原子またはメデル基、、R¹³は水素原子または水酸基の保護基、R²⁰は水素原子またはカルボキシル基の保護基を示す]で表される化合物またはその反応性誘導体と一般式

[0059]

【化22】

HS
$$(CH_2)_m$$
 SO_2 A^1 $[III]$

【式中、R¹⁴は水素原子またはイミノ基の保護基、mは 0ないし4の整数、A¹は式:-N(R¹⁰) R¹⁰【式 中、R¹⁰ およびR¹⁰は同一または異なって、水素原子、 低級アルキル基、低級アルケニル基、低級アルキニル 基、アミノ基もしくはイミノ基の保護基、式:-(CH*

 $OR^{13} \qquad R^{1}$ $COOR^{20} \qquad (CH_{2})_{m} - SO_{2} - A^{1} \qquad [IV]$

[式中、R¹、R¹, R¹, R², A¹およびmは前記の意味を有する]で表される化合物とし、要すれば、一般式 [IV] の化合物の保護基を除去することにより製造される。

【Q062】一般式[II]の化合物と一般式[II

*2) - - N (R⁵⁰) R⁶⁰ (式中、R⁵⁰ およびR⁶⁰ は同一または異なって、水素原子、低級アルキル基またはアミノ基もしくはイミノ基の保護基、nは1ないし3の整数を示す) で表される基、式: - (CH₂) - - N⁶ (R⁷) (R⁶) R⁶ (式中、R⁷、R⁶ およびR⁶ は同一または異なって、低級アルキル基を示し、nは前記の意味を有する) で表される基または該低級アルキル基が互いに結合して式: - (CH₂) - (式中、pは2ないし5の整数を示す) で表される基を示す} で表される基または式:

10 [0060]

【化23】

(式中、B¹は酸素原子、硫黄原子、スルフィニル基、 スルホニル基、式:-N (R¹⁰⁰) - (式中、R¹⁰⁰は保 護されていてもよいカルポキシル基、カルバモイル基、 ジ低級アルキルカルバモイル基、低級アルコキシカルポ ニル基、シアノ基、保護されていてもよいアミノ基、ジ 20 低級アルキルアミノ基および保護されていてもよい水酸 基からなる群より選ばれる置換基を有していてもよい低 級アルキル基、水素原子、低級アルケニル基、低級アル キニル基、低級アルカノイル基、カルバモイル基、ジ低 級アルキルカルバモイル基、低級アルコキシカルポニル 基またはイミノ基の保護基を示す)で表される基または 式:-N*(R¹¹) (R¹²⁰) - (式中、R¹¹は低級アル キル基、R120は保護されていてもよいカルボキシル 基、カルバモイル基、ジ低級アルキルカルパモイル基、 低級アルコキシカルポニル基、シアノ基、保護されてい てもよいアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基および保護 されていてもよい水酸基からなる群より選ばれる置換基 を有していてもよい低級アルキル基、低級アルケニル基 または低級アルキニル基を示す)で表される基を示す} で表される基を示す]で表される化合物とを反応させ て、一般式

[0061]

【化24】

[]の化合物との反応は、特に一般式[II]の化合物として、その反応性誘導体を一般式[III]の化合物と反応させることが良好である。即ち、一般式[II]の化合物に不活性有機溶媒中、塩基の存在下で活性化試50薬を反応させて、一般式

[0063] 【化25】

[式中、Yは脱離基を示し、R¹、R^{1]}およびR²⁰は前 記の意味を有する]で表される反応性誘導体に誘導す る.

【0064】反応に使用する不活性有機溶媒としては、 例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキ サン、ベンゼン、トルエン、クロロベンゼン、塩化メチ レン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、ト リグロロエチレン、アセトン、酢酸エチル、アセトニト リル、N,N-ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルり ん酸トリアミド等または上記溶媒の混合物であり、特に アセトニトリル、ペンセンが好ましい。

【0065】反応に使用する塩基としては、例えばトリ メチルアミン、トリエチルアミン、N,N-ジイソプロ ピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、N-メチル ピロリジン、N-メチルピペリジン、N. N-ジメチル アニリン、1, 8 - ジアザビシクロ [5, 4, 0] ウン デカー 7 -エン (D B U) 、 1, 5 -ジアザビシクロ [4.3.0] ノナー5-エン (DBN) 等の第3級脂 肪族アミン:例えばピリジン、4-ジメチルアミノビリ ジン、ピコリン、ルチジン、キノリン、イソキノリン等 の芳香族アミン等が挙げられ、特にN、N-ジイソプロ ピルエチルアミン、トリエチルアミンが好ましい。

【0066】反応に使用する活性化試薬としては、例え ばトリフルオロ酢酸無水物、メタンスルホン酸無水物、 トリフルオロメタンスルホン酸無水物、p-トルエンス ルホン酸無水物等の酸無水物:例えばメタンスルホニル クロリド、p-トルエンスルホニルクロリド、ジフェニ ルクロロホスファート等の酸クロリド等が挙げられ、特 にジフェニルクロロホスファートが好ましい。

【0067】一般式 [II'] の基Yは脱離基を意味 し、例えばトリフルオロアセトキシ基、メタンスルホニ ルオキシ基、トリフルオロメタンスルホニルオキシ基、 p - トルエンスルホニルオキシ基、ジフェノキシホスホ リルオキシ基等が挙げられ、特にジフェノキシホスホリ ルオキシ基が好ましい。

【0068】反応は一般式 [II] の化合物 1 モルに対 して、塩基1~3モル、好ましくは1~1.5モル、活 性化試薬1~1.2モルが使用される。

【0069】反応は−40~50℃、好ましくは−20 ~20℃の温度範囲で行い、通常0.5~3時間で定量 的に完結する。

50 式 [I I] の反応性誘導体 [I I '] が定量的に得られ

【0071】一般式 [II'] の化合物は単離し、また は単離することなく、一般式[III]の化合物と反応 させることができる。反応は、前記記載の不活性有機溶 媒および塩基を用いて行われ、一般式[II']の化合 物1モルに対して、塩基1~2モル、好ましくは1~ 1. 5モル、一般式 [III] の化合物 1~1. 2モル が使用され、−40~50℃、好ましくは−20~20 10 ℃の温度範囲で行われ、通常0.5~3時間で定量的に 完結する.

【0072】また、一般式 [IV] の化合物は、一般式 [II] の化合物から、一段階で製造することもでき る。即ち、一般式 [I I] の化合物から誘導した一般式 [I I '] の反応性誘導体を単離することなく、一般式 [III] の化合物を同一反応系で反応させて、一般式 [IV] の化合物を効率良く製造することができる。 — 段階で行う場合には、一般式[II]の化合物1モルに 対して、塩基2~4モル、好ましくは2.5~3.5モ ルを用いる。

【0073】反応終了後、通常の処理を行い、一般式 [IV] で表される粗生成物を得、精製することなく脱 保護反応に付すことができるが、粗生成物 [IV] は結 晶化またはシリカゲル等によるカラムクロマトグラフィ 一に付し、精製することが好ましい。

【0074】このようにして得られた一般式 [IV] の 化合物から、必要に応じて、水酸基、アミノ基、イミノ 基およびカルポキシル基の保護基の除去反応を適宜組み 合せて行うことにより、一般式 [I] の化合物を得るこ とができる。

【0075】保護基の除去はその種類により異なるが、 常法に従って、例えば加容媒分解、化学的還元または水 素化により行われる。

【0076】前記一般式 [IV] において、水餃基およ び/またはアミノ基もしくはイミノ基の保護基が、例え ぱペンジルオキシカルポニル基、 p -ニトロペンジルオ キシカルポニル基等のア ラルキルオキシカルポニル基 で、カルボキシル基の保護基が、例えばベンジル基、p - 二トロベンジル基、ベンズヒドリル基等のアラルキル 基である場合には、例えば酸化白金、白金線、白金黒等 の白金融媒;例えばパラジウム黒、酸化パラジウム、パ **ラジウム‐炭素、水酸化パラジウム-炭素等のパラジウ** ム触媒等を用いる接触水素化により保護基を除去するこ とができる。

【0077】接触水素化反応に用いる溶媒としては、例 えばメタノール、エタノール、テトラヒドロフラン、ジ オキサン、酢酸等またはこれらの有機溶媒と水あるいは りん酸塩等の緩衝液との混合溶媒が挙げられる。

【0078】反応は、1~4気圧の水素ガス気流下に0 【0070】反応終了後、常法に従って処理して、一般 50 ~50℃の温度範囲で、0.5~4時間で完結する。

[0079] 前記一般式 [IV] において、水酸基およ び/またはアミノ基もしくはイミノ基の保護基が、例え ばアリルオキシカルポニル基で、カルポキシ基の保護基 が、例えばアリル基である場合には、アリル基の捕捉剤 を含有する不活性有機溶媒中、有機可溶性のパラジウム 錯体触媒を反応させて保護基を除去することができる [マッコムピ (McCombie) 等の方法、ザ ジ ャーナル オブ オーガニック ケミストリー(). Org. Chem.)、第47巻、587~590頁 の方法、同一文献、第52巻、4984~4993(1 987年)参照]。

【0080】反応に用いる溶媒としては、例えば水、ア セトン、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオ キサン、酢酸エチル、アセトニトリル、塩化メチレン、 クロロホルムまたはこれらの混合溶媒が挙げられる。

【0081】この反応に使用される好適なパラジウム触 媒としては、例えばパラジウムー炭素、水酸化パラジウ ムー炭素、塩化パラジウム(II)、酢酸パラジウム (II)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラ 20 ジウム(0)、テトラキス(トリフェノキシホスフィ ン) パラジウム (0) 、テトラキス (トリエトキシホス フィン) パラジウム(0)、ビス [エチレンピス(ジフ ェニルホスフィン)]パラジウム(0)、テトラキス [トリ(2-フリル)ホスフィン]パラジウム(0)、 ピス (トリフェニルホスフィン) パラジウム ([[]) クロリド、ピス (トリフェニルホスフィン) パラジウム (II) アセタート等が挙げられる。

【0082】アリル基の捕捉剤としては、例えばジメド ン、ぎ酸、酢酸、ぎ酸アンモニウム、ぎ酸ナトリウム、 2-エチルヘキサン酸ナトリウム、2-エテルヘキサン 酸カリウム、ピロリジン、ピペリジン、水素化トリプチ ルすず等を挙げることができる。

【0083】反応は、一般式 [IV] の化合物1モルに 対して、触媒 0.01~0.5モル、捕捉剤1~6モル を使用し、-10~50℃の温度範囲、好ましくは0~ 30℃の温度範囲で行われ、通常0.5~3時間で完結 する。

【0084】また、前記一般式[IV]において、水酸 基および/またはアミノ基もしくはイミノ基の保護基が 40 0-二トロベンジルオキシカルポニル基で、カルポキシ ル基の保護基がoーニトロペンジル基である場合には、 光反応によって保護基を除去することができる [アミッ ト (Amit) 等の方法、ザ ジャーナルオブ オーガ ニック ケミストリィ(J. Org. Che

m.)、第39巻、192~196 (1974年) 参

52

【0085】保護基の除去反応の終了後、通常の処理法 により、例えばシリカゲルまたは吸着樹脂等を用いるカ ラムクロマトグラフィーに付し、凍結乾燥または結晶化 等の操作により、一般式[I]の化合物を単離すること ができる。

【0086】尚、一般式 [IV] の化合物の3位のカル ボキシル基の保護基が、例えばアセトキシメチル基、ピ (1982年) およびF. グイベ (Guib▲e▼) 等 10 パロイルオキシメチル基等の低級アルカノイルオキシア ルキル基;例えばメトキシメテル基;インダニル基;フ タリジル基等である場合、このようなエステルは生体内 で生理的に加水分解されるので、保護基を除去すること なく、直接、ヒトまたは動物に投与することができる。

> 【0087】一般式[II]で表される出発原料は、例 えば、R¹が水素原子である場合、サルツマン(Sal zmann) 等の方法 [ジャーナル オプ ジ アメリ カンケミカル ソサエティ (J. Am. Chem.

> Soc.)、第102巻、6161~6163頁(1 981年) 参照]; R¹がメテル基である場合、シー (Shih) 等の方法 [ヘテロサイクルズ (Heter ocycles)、第21巻、29~40頁(1984 年) 参照] またはそれらに準ずる方法に従い製造され

> 【0088】一般式[III]で表される出発原料は以 下の方法により合成した。

【0089】化合物11の水酸基を活性誘導体12に変 換した後、常法に従ってチオシアン酸カリウム、チオ酢 酸カリウム、硫化ナトリウム、トリチルメルカプタン等 との反応により化合物13に誘導した。化合物13をア クタ ヘミカ スカンジナビカ セリエス B(Act a Chem. Scand. Ser. B)第36 巻(10)、669頁(1982年)、テトラヘドロン レターズ (Tetrahedron Lett.) 第 23巻、5389頁(1982年);同、第30巻、2 869頁(1989年)記載の方法によりスルホニルク ロリド14とし、次いで一般式[III]の化合物を形 成すべき所望のアミン誘導体を反応させて、スルホンア ミド15に変換した。化合物15の水酸基を常法により 活性化した後、チオ酢酸カリウム等のチオ酢酸塩を反応 させて、アセチルチオ誘導体17とし、次いでアルカリ 加水分解または酸加水分解により一般式 [I I I] で表 されるチオール誘導体を得た。

[0090]

【化26】

[式中、R15は水素原子または水酸基の保護基、R16は 水素原子、アセチル基、シアノ基またはトリチル基、X は塩素原子、臭素原子、よう素原子、トリフルオロアセ 30 トキシ基、メタンスルホニルオキシ基、トリフルオロメ タンスルホニルオキシ基、pートルエンスルホニルオキ シ基からなる群から選ばれる脱 雞基、Acはアセチル 基、R¹⁴、A¹およびmは前記の意味を有する]

mが1ないし4の整数である化合物<math>11は、4-ヒドロキシプロリンを所望によりk回(k=0~3)の増炭反*

[式中、kは0ないし3の整数、R¹⁴、R¹³およびmは 前記の意味を有する]。

【0092】前記の増炭反応は、以下のように行うこと ができる。

【0093】 4-ヒドロキシプロリン<u>1</u>のカルボキシル基を常法によりエステル化した後、化合物<u>2</u>のイミノ基 および水酸基を所望により常法に従い保護した。

*応に付すことにより得られた、ωー(4 ーヒドロキシピ ロリジン-2-イル)アルカンカルボン酸<u>8</u>よりジャー ナル オブ メディシナル ケミストリィ (J. Chem.) 第3-1 巻、875頁(1988 年);同、第31巻、1598頁(1988年)の方法 に従って得ることができる。

[0091] 【化27】

て [オーガニック リアクション(〇rg. t.)、第6巻、469頁(1951年)、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー (J. Chem.)、第24巻、627頁 (1959年) 等〕アルコール体<u>5</u>を得た。化合物<u>5</u>を用いて、常法に よりハロゲン化物またはスルホン酸エステルとした後、 シアン化合物<u>6</u>に変換した [シンセティック コミュニ 【0094】化合物<u>4</u>のエステル基を常法により還元し¹ 50 ケーションズ(Synth. Commun.)、第2

巻、125頁 (1972年)]。化合物<u>6</u>を常法に従っ て塩酸で処理することにより、化合物7が得られた。増 炭反応は所望により、0ないし3回行うことができる。

* [0095] . 【化28】

HO
$$\longrightarrow$$
 HO \longrightarrow H

[式中、RいおよびRいは前記の意味を有する]。 【0096】mが0である化合物11は、4-ヒドロキ 20 とができる。 シー2-ピロリドン9を常法に従って水酸基を保護して 化合物 10とし、次いでヘテロサイクルズ(Heterocycles) 第26巻、617頁 (1987年) に※

※記載の方法に従って還元反応を行うことによって得るこ

[0097] 【化29】

[式中、RII およびRII は前記の意味を有する]。

【0-0 9 8】本発明の化合物の有用性を具体的に示すた めに、細菌に対する試験管内抗菌活性を下記の寒天平板 希釈法により測定した [日本化学療法学会標準法:ケモ テラピー (Chemotherapy) 、第29巻、7 6~79頁(1981年)]。 ミューラー ヒントン プロス (Mueller Hinton broth) 中で一夜培養した各試験菌株の一白金耳(接種菌量: 1★

30★0° CFU/ml) をミューラー ヒントン アガー (MH agar) に接種した。この培地には抗菌剤が 各溴度で含まれており、37℃で16時間培養した後、 最小発育阻止遺度(MIC:μg/ml)を測定した。 その結果を表に示す。

[0099] 【表11】

最小発育阻止濃度(MIC:μg/ml) 表1

試 験 菌	実施例1の化合物	実施例3の化合物
Saureus 209P NIHJ JC1	0.025	0.012
Saureus MB4970	0.025	0.012

本発明の化合物は、種々のグラム陽性菌およびグラム陰 性菌に対して優れた抗菌活性を有し、これら病原菌を起 炎菌とするヒトの細菌感染症の治療および予防に、抗菌 剤として有用な化合物である。本発明の抗菌剤に感受性 のある代表的な病原体としては、例えばスタフィロコッ カス (Staphylococcus) 属、エンテロコ

ッカス (Enterococcus) 属、エシェリキア (Escherichia) 属、エンテロパクター (E nterobacter) 属、クレプシェラ (Kleb siella) 属、セラチア (Serratia) 属、 プロテウス (Proteus) 属、シュードモナス (P seudomonas) 属等の菌種を挙げることがで

50

き、特にメチシリン耐性スタフィロコッカス アウレウ ス (methicillin resistant S taphylococcus aureus) およびチ エナマイシン耐性シュードモナス アエルギノーサ (t hienamycin resistant Pseu domonasaeruginosa) に対して優れた 抗菌活性を示した。

【0100】本発明の化合物は、各々の化合物によって 異なるが、DHP-Iに対して極めて安定であり、且つ

【0101】本発明化合物は、当分野で公知の固体また は液体の賦形剤の担体と混合 し、非経口投与、経口投 与、外部投与に適した医薬製剤の形で使用することがで きる。主なものは、局所的または注射による非経口的 (静注または筋注) な投与である。医薬製剤としては、 例えば注射剤、シロップ剤、乳剤等の液剤;錠剤、カプ セル剤、粒剤等の固形剤;軟膏、坐剤等の外用剤が挙げ られる。これらの製剤には、必要に応じて塩基、助剤、 安定化剤、湿潤剤、乳化剤、吸収促進剤、界面活性剤等 20 の通常使用される添加剤が含まれていてもよい。

【0102】添加剤としては例えば注射用蒸留水、リン ゲル液、グルコース、しょ糖シロップ、ゼラチン、食用 油、カカオ脂、エチレングリコール、しょ糖、とうもろ こし政粉、ステアリン酸マグネシウム、タルク等が挙げ られる。

【0103】投与量は、患者の症状、体重、年齢、性 別、投与形態、投与回数等によって異なるが、通常、成 人に対する好ましい日用量は有効成分約5~50mg/ kg、子供に対する好ましい日用量は約5~25mg/ 30 D:O: 重水 kgの範囲にあり、1日当り1回または数回に分けて投 与するのが好ましい。

【0104】本発明の化合物は、必要に応じてシラスタ チン[(Z)-7-(L-アミノ-2-カルポキシエチ ルチオ) -2- (2, 2-ジメチルシクロプロパンカル ボキサミド) -2-ヘプテノイン酸ナトリウム] 等のD HP-I阻害剤 [特開昭56-81518号公報、欧州 特許出願第28,778号、ジャーナル オブ メディ シナル ケミストリィ (J. Med. Che m.)、第30巻、1074頁 (1987年)] と組合 40 せて投与することもできる。

[0105]

【実施例】実施例および参考例を挙げて本発明を更に具 体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定さ れるものではない。

【0106】実施例および参考例の薄層クロマトグラフ は、プレートとしてSilicagel 60F

zes(Merck)を、検出法としてUV検出器または ニンヒドリン発色法を用いた。カラム用シリカゲルとし てはWakoge!™ C-300 (和光純薬)を、逆 相カラム用シリカゲルとしてはLC-SORB™SP-B-ODS (Chemco) またはYMC・GEL™ ODS-AQ120-S50を用いた。高速液体クロマ トグラフとしては、JASCOM 800シリーズ (日 本分光)を用いた。 NMRスペクトルは、重ジメチル スルホキシドまたは重クロロホルム溶液で測定する場合 物理化学的安定性および水に対する溶解性にも優れてい 10 には内部基準としてテトラメチルシラン(${
m TMS}$)、重 水溶液で測定する場合には2.2-ジメチル-2-シラ ペンタン-5-スルホナート(DSS)を用い、XL-200 (200MHz; Varian) 型スペクトロメ 一夕を用いて測定し、全δ値をppmで示した。 【0107】NMR測定における略号の意味を以下に示

S:シングレット

d:ダブレット

t:トリプレット

Q:クワルテット

ABq:AB型クワルテット

dd:ダブル ダブレット

m:マルチプレット br:ブロード

J:カップリング定数

Hz:ヘルツ

DMSO-d6:重ジメチルスルホキシド

CDCl₃:重クロロホルム CD3OD: 重メタノール

反応式における略号の意味を以下に示す。

Ac:アセチル基

Me:メチル基

Ms:メタンスルホニル基

PNB: 4-二トロペンジル基

PNZ: 4-二トロペンジルオキシカルボニル基 TBDMS:tert-ブチルジメチルシリル基

実施例1

ナトリウム (1 R. 5 S. 6 S) - 6 - [(R) - 1 <u>ーヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S.4</u> <u>S) - 2 - スルファモイルメチルピロリジン - 4 - イル</u> <u>テオ] - 1 - カルバペン- 2 - エム - 3 - カルボキシラ</u> ート

1 a)

[0108]

【化301

AoS SO₂NH₂ SO₂NH₂ SO₂NH₂ SO₂

(25, 45) -4-アセチルチオ-N-(4-ニトロ ペンジルオキシカルポニル) -2-スルファモイルメチ ルピロリジン (90mg, 0. 22mmol) 、メタノ ール (0.5 ml) の溶液に氷冷下 2 N水酸化ナトリウ ム (0. 11ml) を加え、この混合液を30分間撹拌 した。6N塩酸 (36μ1) を加えた後、反応液に酢酸 エチル (20ml) を加え、この溶液を飽和食塩水で3 回洗浄、脱水、遺縮した。残渣に4-二トロベンジル (1R, 5S, 6S) - 2 - ジフェノキシホスホリルオ キシー6- [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メ チルー1ーカルパペンー2ーエムー3ーカルポキシラー ト (128mg, 0. 22mmol)、アセトニトリル (2ml) を加え、氷冷下N、N-ジイソプロピルエチ ルアミン (38 µ l, 0, 22 mmol) を滴下し、こ の溶液を同温度で18時間撹拌した。反応液に酢酸エチ ル (20ml) を加えた後、この溶液を飽和炭酸水素ナ トリウム水および飽和食塩水で順次洗浄し、有機層を脱 水、濃縮した。残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロ マトグラフィー (Wakogel™C-300, 40m 1;酢酸エチルで溶出)にて精製し、4-二トロペンジ*

*ル (1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -N-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル) -2-スルフ 7 アモイルメチルピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルボキシラート (117m イン・2、収率:75.5%) を得た。

60

[0109] NMR (CDCl₃+CD₃OD) δ : 1. 26 (3H, d, J=7Hz), 1. 32 (3H, d, J=6Hz), 2. 2 (1H, m), 2. 75 (1H, m), 3. $2 \sim 3$. 4 (4H, m), 3. $6 \sim 4$. 1 (3H, m), 4. $1 \sim 4$. 3 (2H, m), 4. 42 (1H, m), 4. 22 (2H, br s), 4. 24 (1H, d, J=14Hz), 4. 50 (1H, d, J=20 + 14Hz), 7. 52 (2H, br d, J=8Hz), 7. 65 (2H, d, J=8Hz), 8. 21 (2H, d, J=8Hz), 8. 22 (2H, d, J=8Hz)

1 b)

[0110]

【化31】

(1 R. 5 S. 6 S) - 6 -4 - ニトロペンジル [(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メテル-2-[(2 S. 4 S) -N- (4-二トロペンジルオキシカ ルポニル) -2-スルファモイルメチルピロリジン-4 ーイルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポ キシラート (117mg, 0.16mmol)、テトラ ヒドロフラン (5ml)、0.1 Mリン酸緩衝液 (pH 7. 5 m l) の溶液に 10% パラジウム炭素 (60 m g) を加え、この溶液を水素気流中1時間撹拌した。触 媒を濾別後、減圧下に有機溶媒を除去し、析出した不溶 物を濾別した。水層を酢酸エチル(5ml)で洗浄した 後、再度遺縮した。遺縮液を逆層カラムクロマトグラフ 1- [YMC · GELI ODS - AQ120 - S5 0. 50ml;メタノール-水(1:9)で溶出]にて 精製し、目的物を含む画分を浪縮、凍結乾燥して標記化 合物 (33mg, 収率:47.5%) を得た。

[0111] IR (KBr) cm-1:1750, 159

0, 1390, 1330, 1290, 1260, 114

NMR (D₂O) δ : 1. 20 (3 H. d. J = 7 H z), 1. 28 (3 H. d. J = 6 H z), 1. 85 (1 H. m), 2. 9 (1 H. m), 3. 3 ~ 3. 5 (3 H. m), 3. 6 ~ 3. 8 (3 H. m), 4. 0 (1 H. m), 4. 1 ~ 4. 3 (3 H. m)

40 実施例 2

(1R. 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-(N-メチルスルファモイルメチル) ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エム-3-カルポン酸

__ 2 a)

[0112]

【化32】

62 COOPNB ΡNΖ ΡNΖ

(2S. 4S) - 4-アセチルチオ-2- (N-メチル スルファモイルメチル) - N - (4-ニトロペンジルオ キシカルポニル) ピロリジン (637mg, 1.48m mol)、2N水酸化ナトリウム(0.75ml)、6 N塩酸 (0.24ml)、4-二トロペンジル R, 5S, 6S) -2-ジフェノキシホスホリルオキシ -6-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル - 1 - カルバペン - 2 - エム - 3 - カルポキシラート (877mg, 1. 48mmol) およびN, Nージイ ソプロピルエチルアミン (0.26ml, 1.48mm ol)を用いて、実施例1a)と同様の反応を行い、4 - ニトロペンジル (1 R, 5 S, 6 S) - 6 -[(R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-2-チル) - N - (4 - ニトロペンジルオキシカルボニル) *

61

*ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルパペン-2-エ ム-3-カルポキシラート(779mg, 収率:71. 8%) を得た。

[0113] NMR (CDC13) δ : 1. 28 (3 H, m), 1.36 (3H, d, J = 5. 94Hz), 2. 25 (1 H, m), 2. $70 \sim 2$. 83 (4 H, m), 3. 27 \sim 3. 42 (4H, m), 3. 76 \sim 4. 43 (6 H, m), 5. 22 (3 H, m), 5. 5 0 (1 H, d, J = 14.04), 7.53 (2 H, m), 7.65 (1H, d, J = 8.91 Hz), 8. 20 (4H, m)

2 b) [0114] 【化33】

上記反応で得られた化合物(763mg, 1.04mm o 1) および10%パラジウム炭素(380mg)を用 いて、実施例1b)と同様の反応を行った。水層を逆相 クロマトグラフィー [YMC・GELT ODS-AQ 120-550, 50ml;メタノールー水 (1: 9) で溶出]に付し、目的画分を凍結乾燥して標記化合 物 (56.4mg, 収率:13%) を得た。

[0115] NMR (D₂O) δ : 1. 17 (3 H. d, J = 7. 24 Hz), 1. 25 (3 H, d, J =6. 27 Hz), 1. 45 (1 H, m), 2. $53 \sim$ 2. 71 (4H, m), 2. 90 (1H, m), 3. 2% $\times 0 \sim 3$. 56 (5 H, m), 3. 72 (1 H, m), 4. 20 (2H, m)

実施例3

(1R. 5S. 6S) -6- [(R) -1-ヒドロキシ <u>エチル] -1-メチル-2-[(25, 45) -2-</u> [N-[2-(N-メチルアミノ) エチル] スルファモ イルメチル] ピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバ ペン-2-エム-3-カルボン酸 塩酸塩

3 a)

[0116]

【化34】

(2S, 4S) -4-Pセチルテオ-2-[N-[2-[N-メチル-N-(4-ニトロペンジルオキジカルボ ニル) アミノ] エチル] スルファモイルメチル] - N -(4-二トロペンジルオキシカ ルポニル) ピロリジン (1.03g, 1.60mmol)、2N水酸化ナトリ

ニトロペンジル (1 R. 5 S. 6 S) - 2 - ジフェノ キシホスホリルオキシ-6-[(R)-1-ヒドロキシ エチル] -1-メチル-1-カルパペン-2-エム-3 ーカルポキシラート (954mg, 1.60mmol) およびN、Nージイソプロピルエチルアミン(0.28 ウム (0.8 ml)、6 N塩酸 (0.27 ml)、4 - 50 ml.1.60 mmol) を用いて、実施例1a) と同

*2. 20 (1H, m), 2. 71 (1H, m), 3. 0

様の反応を行い、4-二トロペンジル (1R.5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S)-2-[N-[2-(N -メチル-N- (4-二トロペンジルオキシカルポニ ル) アミノ] エチル] スルファモイルメチル] -N-(4-二トロペンジルオキシカルポニル) ピロリジン-4-イルチオ]-1-カルバペン-2-エム-3-カル ポキシラート (914mg, 0.968mmol) を得 た。

1 (3 H, s), 3. $0.5 \sim 3.60 (9 \text{ H, m})$, 3. 76 (2H, m), 4. 25 (3H, m), 5. 2 0 (5 H, m), 5.50 (1 H, d, J=13.8 H)z), 7. 50 (4H, d, J=7. 83Hz), 7. 64 (2 H, d, J = 8.64), 8.19 (6 H. 3 b) [0118]

[0117] NMR (CDC11) δ : 1. 25 (3 10 【化35】 H, m), 1. 34 (3H, d, J = 6. 21Hz), *

上記反応で得られた化合物 (914mg, 0.968m mol) および10%パラジウム炭素(500mg) を 用いて、実施例1b)と同様の反応を行った後、水層を 逆相クロマトグラフィー [YMC・GELT ODS-AQ120-S50, 50ml;メタノールー水(1: 4) で溶出]に付した。目的画分の溶出液のpHを1N 塩酸で6.5に調節し、凍結乾燥して標記化合物(18 6.5mg, 収率:38.6%) を得た。

[0119] NMR (CDC1₃) δ : 1. 08 (3) H, d, J = 7.26 Hz), 1.15 (3 H. d. J= 6. 27 Hz), 1. 58 (1 H, m), 2. 70(1 H, m), 3. $10 \sim 3$. 60 (11 H. m), \times $3.70\sim3.80$ (2H, m), 4.05 ~4.13 (2H, m)

実施例4

(1R. 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシ エチル] - 1 - メチル - 2 - [(2 S. 4 S) - 2 -(1-ピペラジニルスルホニルメチル) ピロリジン-4 <u>-イルチオ] -1-カルバベン-2-エム-3-カ</u>ルボ

ン酸 塩酸塩

4 a) [0120]

【化36】

(2S, 4S) - 4 - アセチルチオ-N- (4-ニトロ ベンジルオキシカルボニル) -2-[4-(4-二トロ ペンジルオキシカルポニル) -1-ピペラジニルスルホ ニルメチル] ピロリジン (900mg, 1.35mmo 1)、2N水酸化ナトリウム(1.33ml)、6N塩 酸 (0.44ml)、4-二トロペンジル(1R,5 S, 6 S) - 2 - ジフェノキシホスホリルオキシー6 -[(R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メテル-1-カルパペン-2-エム-3-カルポキシラート(792 mg, 1. 33mmol) およびN, Nージイソプロピ ルエチルアミン (0.23 ml, 1.33 mmol) を 50 6.3 Hz), 2.3 (1 H, m), 2.7 (1 H,

用いて、実施例la)と同様の反応を行い、4-二トロ ベンジル (1R, 5S, 6S) -6-[(R) -1-ヒドロキシエテル] -1-メチル-2-[(25, 4 S) -N- (4-ニトロペンジルオキシカルポニル) -2- [4-(4-ニトロペンジルオキシカルポニル)-1-ピペラジニルスルホニルメチル] ピロリジン-4-イルチオ] - 1 - カルバペン - 2 - エム - 3 - カルボキ シラート (1.05g、収率:87.3%) を得た。 [0121] NMR (CDC11) δ : 1. 28 (3) H, d, J = 7. 3 H z) 1. 3 6 (3 H, d. J =

m), 3. 1~4. 0 (16H, m), 4. 3 (2H, m), 5. 2 (5 H, m), 5. 5 (1 H, d, J=14 H z), 7. 5 (2 H, d, J = 8.6 H z), 7. 64 (2H, d, J=8.6Hz), 8.22 (2H. d, J = 8.6 Hz), 8.23 (4H, d, J = 8.*

*6Hz) 4 b) [0122] 【化37】

上記反応で得られた化合物 (1.05g, 1.17mm ol) および10%パラジウム炭素 (500mg) を用 いて、実施例1b)と同様に反応を行った後、水層を逆 相クロマトグラフィー [YMC・GELT ODS-A 20 0, 1330, 1310, 115-0 Q 120-S50, 50ml;メタノール-水(1: 4) で溶出]に付した。溶出液のpHを1N塩酸で6. 5に調節し、凍結乾燥して標記化合物(193mg, 収 率:32%)を得た。

[0123] NMR (D2O) δ : 1. 21 (3H, d, J = 6. 9 H z), 1. 28 (3 H, d, J = 6. 6 Hz), 1. 7 (1 H, m), 2. 8 (1 H, m), % $3. 2 \sim 3. 8 (14 H, m), 3. 9 \sim 4. 0 (2)$ H. m), 4. $2 \sim 4$. 3 (2H, m) IR (KBr) cm⁻¹: 1750, 1600, 139 参考例1

66

<u>(2 S. 4 S) - 4 - アセチルチオーN - (4 - ニトロ</u> ベンジルオキシカルポニル) -2-スルファモイルメチ ルピロリ<u>ジン</u>

1 a) [0124] [化38]

HO,

氷冷下、メタノール(170ml)にアセテルクロリド (19ml. 270mmol) を滴下した溶液に、L-ヒドロキシプロリン (25g, 190mmol) を加 え、この溶液を7時間加熱撹拌した。反応液を室温まで 冷却した後、ジエチルエーテル(340ml)を加え、 5℃でさらに1時間撹拌した。折出した結晶を濾取し、 ジエチルエーテルーメタノール (2:1) の混液 (50 ml) で洗浄した後、窒素気流下、4時間乾燥してL-ヒドロキシプロリン メチルエステル塩酸塩 (30.6★40

★4g, 収率:89%) を得た。

[0125] NMR (DMSO-d₆) δ: 2. 14 (2 H. m). 3. 1 (1 H. d. J = 1 2 Hz). 3. 4 (1 H. dd. J = 4 & 12 Hz), 3. 82 (3 H. s), 4. 48 (2 H. m), 5. 66 (1 H. br s), 9, 9 (2H, brs) 1 b)

[0126] [化39]

上記反応で得られた化合物 (27.2g.0.15mo 1) のクロロホルム (500ml) 懸濁液に、トリエチ ルアミン (50.0ml, 0.36mol) を加え溶解 させた。この中に4、6-ジメチル-2-(4-二トロ ペンジルオキシカルボニルチオ)ピリミジン(40.750 ゲルカラムクロマトグラフィー(Wakogelite C

g. 0. 13mol) を加え室温で12時間撹拌した。 反応液を水 (200ml), 0.5N水酸化ナトリウム 水溶液 (400ml)、飽和食塩水 (200ml) で順 次洗净後、乾燥 (MgSO₁) 濃縮した。残渣をシリカ

68 .

-300;酢酸エチルで溶出)で精製して、(2S, 4R) -4-ヒドロキシ-N-(4-ニトロペンジルオキシカルポニル) プロリン メチルエステル (34.5g, 収率:70.9%) を油状物として得た。

【0127】NMR(CDCli)δ:1.90~2. 45(2H, m), 3.60~3.90(2H, m), 3.66および3.76(3H, それぞれs), 4.5* *6 (1 H, m), 5. 24および5. 26 (2 H, AB q, J = 12 H z, Δν = 40 H z およびs), 7. 46および7. 52 (2 H, それぞれd, J = 8 H z), 8. 24 (2 H, d, J = 8 H z) 1 c) [0128] [化40]

上記反応で得られた化合物(48.2g, 0.15mo 1)およびイミダゾール(20.2g, 0.30mo 1)のN, N-ジメチルホルムアミド(480ml)溶液に、室温で tert-ブチルジメチルシリルクロリド(<math>26.9g, 0.18mol)を加え、この溶液を同温度で 1.5時間撹拌した。反応液を飽和重曹水(<math>200ml)中に注ぎ、酢酸エチル(500ml)で抽出した。有機層を乾燥(MgSOl)、濃縮し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー [$Wakogel^{TV}$ C-300:酢酸エチル(1:3)で溶出]で精製して、(2S,4R) -4-tert-ブチルジメチルシロキシ-N-(<math>4-ニトロペンジルオキシカル※

※ボニル)プロリン メチルエステル (61.7g, 収率:95%) を油状物として得た。

【0129】NMR (CDCl₁) る:0.06(6 H, s), 0.86(9H, s), 2.0~2.4(2 H, m), 3.40~3.80(2H, m), 3.66 および3.78(3H, それぞれs), 4.46(2 H, m), 5.20(2H, m), 7.50(2H, m), 8.24(2H, d, J=8Hz) 1d)

[0130] [(£41]

上記反応で得られた化合物 (50.8g, 0.11mo 30★1)のテトラヒドロフラン (508ml)溶液に水素化ほう素ナトリウム (10.5g, 0.28mol)を加え、この溶液を室温で30分間撹拌した。この溶液にエタノール (1.02l)を加えた後、反応液を50℃に加温し、3時間撹拌した。反応液を室温までに放冷し、酢酸(17ml)を加えた後、減圧下で溶媒の大部分を留去した。残渣に酢酸エチル (11)を加え、飽和重曹水 (500ml)で洗浄した。有機層を乾燥 (MgSO)し、その濾液を濃縮した。油状残渣を5℃で一夜 40 放置すると固化した。結晶をジエチルエーテルーへキサン (1:10)で洗浄し、濾取し、乾燥して (2S, 4R)-4-tert-ブチルジメチルシロキシ-2-ヒドロキシメチル-N-(4-ニトロペンジルオキシカル★

30★ボニル) ピロリジンの結晶 (38.2g, 収率:80%) を得た。
【0131】 NMR (CDCl;) δ:0.04 (3

H, s), 0. 0 6 (3 H, s), 0. 8 6 (9 H, s), 1. 60 ~ 1. 3 0 (1 H, m), 1. 9 0 ~ 2. 1 0 (1 H, m), 3. 5 0 (2 H, m), 3. 6 2 (1 H, m), 3. 7 6 (1 H, m), 4. 2 0 (1 H, m), 4. 3 6 (1 H, m), 5. 2 8 (2 H, A B q, $J_{15} = 1.4 \, \text{Hz}$, $\Delta v_{15} = 2.0 \, \text{Hz}$), 7. 5 0 (2 H, d, $J = 8 \, \text{Hz}$)

40 8Hz) le) [0132] 【化42]

上記反応で得られた化合物(11~04g、26、89 50 mmol)、トリエチルアミン(4、13m1、29、

*た。

58mmol)の塩化メチレン(110ml)溶液に、 水冷下メタンスルホニルクロリド(2.18ml,28.23mmol)を滴下し、同温度で30分間撹拌した。反応液を水、飽和炭酸水素ナトリウム水および飽和食塩水で順次洗浄、脱水、濃縮した。残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー[Wakogelで C-300,160ml;酢酸エチルーヘキサン(1:2)で溶出]にて精製し、油状の(2S,4R)ー4ーtertーブテルジメチルシロキシー2ーメシルオキシメチルーNー(4ーニトロペンジルオキシカルボ 10ニル)ピロリジン(13.1g,収率:100%)を得*

[0133] NMR (CDCl₃) δ:0.05 (3 H, s), 0.06 (3 H, s), 0.84 (9 H, s), 2.1 (2 H, m), 2.98 (3 H, s), 3.5 (2 H, m), 4.2~4.7 (4 H, m), 5.25 (2 H, br s), 7.52 (2 H, br d, J=8 Hz), 8.24 (2 H, d, J=8 Hz) lf) [0134] [任43]

上記反応で得られた化合物(13.1g,26.8mm ol)、テオシアン酸カリウム(13.07g,134 mmol)、よう化ナトリウム(8.06g,53.6 mmol)のアセトン(290ml)溶液を20時間加熱撹拌した。減圧下に濃縮した後、酢酸エチル(200 ml)を加え、水および飽和食塩水で順次洗浄、脱水、濃縮した。残渣をシリカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [Wakogel™ C-300,160ml;酢酸エチルーヘキサン(1:4)で溶出]にて精製し、結晶状の(2S,4R)-4-tert-ブチルジメテルシロキシーN-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-2-デオシアノメチルピロリジン(9.93※

[0135] IR (KBr) cm⁻¹: 2160, 170 0, 1520, 1350, 1110NMR (CDC) 13) δ : 0. 06 (3 H, s) . 0. 07 (3 H, s), 0. 85 (9 H, s) . 2. 1 (2 H, m), 3. 2 (1 H, dd, J = 2 & 14 H z), 3. 4~ 3. 8 (3 H, m), 4. 45 (2 H, m), 6. 2~

6. 4 (2 H, m), 7. 5 4 (2 H, br 8 Hz), 8. 2 4 (2 H, d, J=8 Hz) 1 g)

[0136] [化44]

※g、収率:81.8%)を得た。

上記反応で得られた化合物 (3g. 6.64mmol)、酢酸 (30ml) および水 (10ml)の溶液に撹拌下、20℃で塩素ガスを2時間吹き込んだ後、空気を10分間吹き込んだ。反応液に酢酸エチル (100ml)を加え、水および飽和食塩水で順次洗浄、脱水、濃縮した。残渣をテトラヒドロフラン (30ml)に溶解し、洗冷下濃アンモニア水 (3ml)を加え、室温で1時間撹拌した。反応液を減圧濃縮した後、塩化メチレン (10ml)を加えて折出物を濾取し、(2S.4R)-4-ヒドロキシーN-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-2-スルファモイルメチルピロリジン (700mg、収率:29.3%)を得た。

[0137] IR (KBr) cm⁻¹:1690. 152 0. 1430. 1410. 1350. 1310. 120 0. 1140 NMR (DMSO-d₃) δ:2. 1 (2H. m), 3. 1 (1H. m). 3. 3~3. 8 (3H. m). 4. 04 (3H. s). 4 1~4 3 (2H. m)

3. 1 (1 H. m), 3. $3 \sim 3$. 8 (3 H. m), 4. 0 4 (3 H, s), 4. $1 \sim 4$. 3 (2 H. m), 5. 2 4 (2 H, br s), 7. 6 4 (2 H, br d, J = 8 H z), 8. 2 4 (2 H, d, J = 8 H z) 1 h)

【0138】 【化45】

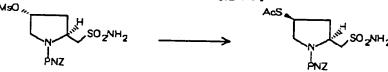
上記反応で得られた化合物(740mg, 2.06mm ol)、トリエチルアミン (0. 43ml, 3. 09m moi)、テトラヒドロフラン (7.4ml) の溶液 に、氷冷下メタンスルホニルクロリド (0.17ml, 2. 16 mmol) を加え、同温度で30分間撹拌し た。析出物を濾別し、濾液を遺縮して、(25,4R) -4-メシルオキシ-N-(4-ニトロペンジルオキシ カルポニル) . - 2 - スルファモイルメチルピロリジン (900mg, 収率:100%) を得た。

* [0139] NMR (DMSO-d₆) δ: 2. 35 (2H, m), 3~3.8 (4H, m), 3.26 (3 H, s), 4. 2 (1 H, m), 5. 3 (3 H, br s), 7. 05 (2H, br s), 7. 62 (2H, b'r d, J = 8 H z), 8. 22 (2H, d, J = 8Hz)

1 i)

[0140]

[1246]



炭酸カリウム(427mg, 3.09mmol)、ジメ チルホルムアミド (7 ml) の溶液に、氷冷下チオ酢酸 (0.22ml, 3.09mmol)、よう化ナトリウ ム(309mg.2.06mmol)および(2S.4 R) -4-メシルオキシ-N-(4-ニトロペンジルオ キシカルボニル) -2-スルファモイルメチルピロリジ 20 ン (900mg, 2.06mmol) のジメチルホルム アミド(2m1)溶液を順次加え、60℃で5時間撹拌 した。反応液に酢酸エチル(100ml)を加え、水お よび飽和食塩水で順次洗浄、脱水、濃縮した。残渣をシ リカゲルフラッシュカラムクロマトグラフィー [Wak ogel^{tv} C-300, 40ml;酢酸エチル-ヘキ サン (2:1) で溶出]にて精製し、標記化合物の (2 S, 4S) - 4-アセチルテオ-N-(4-ニトロペン ジルオキシカルポニル) -2-スルファモイルメチルピ※

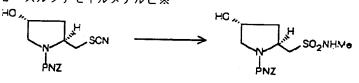
※ロリジン (90mg, 収率:10.5%) を得た。 [0141] NMR (CDCl₃) δ: 2. 1 (2H, m), 2. 36 (3H, s), 2. 72 (1H, m), 3. $2 \sim 3$. 4 (2 H, m), 3. $6 \sim 4$. 2 (3 H, m), 4. 46 (1 H, m), 5. 1 (2 H, s), 5. 22 (2H, s), 7. 51 (2H, d, J = 8Hz), 8. 24 (2H, d, J = 8 H z) 参考例2

<u>(25, 45) - 4 - アセチルチオー2 - (N - メテル</u> スルファモイルメチル)-N-(4-二トロペンジルオ <u>キシカルボニル)ピロリジン</u>

2 a)

[0142]

【化47】



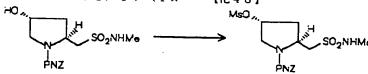
(2S, 4R) -4-ヒドロキシ-N-(4-ニトロペ ンジルオキシカルポニル) -2-チオシアノメチルピロ リジン (3. 37g, 10.0mmol)、メテルアミ ン (2. 33g. 75mmol) を用いて、参考例1 g) と同様の反応を行い、(2 S、4 R) - 4 - ヒドロ キシ-2-(N -メチルスルファモイルメチル)-N-(4-ニトロペンジルオキシカ ルポニル)ピロリジン (1.19g、収率:31.9%)を得た。 [0143] NMR (CDCl₃) δ : 2. 17 (1*

★H, m), 2.38 (1H, m), 2.80 (3H. d. J = 4. 86Hz), 3. 00~3. 90 (4H. m). 4. $1.5 \sim 4$. 60 (2 H, m), 4. 38 (1 H, s), 5. 22 (2 H, s), 7. 50 (2 H. d. J = 8. 64 Hz), 8. 20 (2 H. d. J =8. 64Hz)

2 b)

[0144]

[化48]



上記の反応で得られた化合物(1.18g.3.15m 3. 88 mmol)、トリエチルアミン (0. 478 mol)、メタンスルホニルクロリド (0. 444g, 50 g. 4.73 mmol)を用いて、参考例1h)と同様

の反応を行い、(2S, 4R) -4-メタンスルホニルオキシ-N-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-2-チオシアノメチルピロリジン (820 mg, 収率:57.8%)を得た。

[0145] NMR (CDC1₁) δ : 2. 40 (1 H, m), 2. 63~2. 82 (4H, m), 3. 05 ~3. 20 (4H, m), 3. 30~4. 30 (4H, *

*m), 5. 25 (3H, s), 7. 50 (2H, d, J =8. 10Hz), 8. 23 (2H, d, J=8. 64 Hz) 2c) [0146] [化49]

74

上記の反応で得られた化合物(820mg, 1.82mmol)、チオ酢酸カリウム(620mg, 5.43mmol)およびよう化ナトリウム(268mg, 1.79mmol)を用いて、参考例1i)と同様の反応を行い、(2S,4S)-4-アセチルチオ-2-(N-メチルスルファモイルメチル)-N-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)ピロリジン(636.7mg,収率:81.1%)を得た。

[0 1 4 7] NMR (CDC 13) \hat{o} : 2. 10 (1 H. m), 2. 35 (3H. s), 2. 70~2. 84 (4H. m), 3. 10~3. 35 (2H. m), 3. 81~4. 52 (4H. m), 5. 22 (2H. s), 7. 50 (2H. d. J=8. 10Hz). 8. 22 (2H. d. J=8. 91Hz)

参考例3

3 a)

【0148】 【化50】

4, 6-ジメチル-2- (4-二トロペンジルオキシカルボニルチオ) ピリミジン (14.23g,44.28 mmol) の酢酸エデル (100ml) 溶液に、N-メチルアミノエタノール (3.32g,44.28 mmol) の酢酸エチル (100ml) 溶液を室温下で滴下した。同温で1時間撹拌した後、折出結晶を濾別し、濾液を水、飽和炭酸水素ナトリウム水、飽和食塩水で順次洗净、無水硫酸ナトリウムで脱水、濃縮した。結晶残渣を※

※塩化メチレン-n-ヘプタンで洗浄し、2-[N-メチル-N-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)アミノエタノール(11.09g、収率:98%)を得た。【0149】NMR(CDCl3) δ:3.04(3H,s),3.50(2H,t,J=5.28Hz),3.80(2H,s),5.23(2H,s),7.52(2H,d,J=8.9Hz),8.23(2H,d,J=8.6Hz)3b)【0150】【化51】

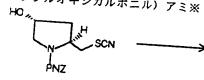
上記反応で得られた化合物 (11.0g,44.3mm ol)、トリエチルアミン(6.63ml)の塩化メチ レン(100ml)溶液に、氷冷下、メタンスルホニル クロリド (3. 52ml) を滴下した。同温で30分間 撹拌した後、反応液を水、飽和炭酸水素ナトリウム水で 洗浄し、無水硫酸マグネシウムで脱水、遺縮した。結晶 残渣を塩化メチレン-イソプロピルエーテルで洗浄し、 2-メタンスルホニルオキシ-1-[N-メチル-N-(4-二トロペンジルオキシカルポニル) アミノ] エタ ン (13.42g, 収率:93.3%) を得た。 [0151] NMR (CDC11) 6:3.04 (6 H. m), 3.65 (2 H, m), 4.38 (2 H, m), 5. 24 (2H, s), 7. 52 (2H, d, J = 8. 56 Hz), 8. 23 (2 H, d, J = 8. 91Hz) 3 c) [0152] 【化521

上記反応で得られた化合物(13.29g.40mmo 501)、フタルイミドカリウム(11.11g.60mm

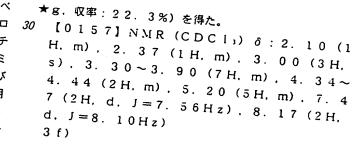
75 ol)、よう化ナトリウム(1. 20g, 8mmol) のDMS〇(300ml)溶液を60℃で2時間加熱撹 **拌した。反応液に酢酸エチルを加え、この溶液をチオ硫** 酸ナトリウム水、飽和炭酸水素ナトリウム水、飽和食塩 水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで脱 水、濃縮し、折出結晶をn-ヘプタンで洗浄し、N-[2-[N-メチル-N-(4-ニトロペンジルオキシ カルボニル)アミノ] エチル] フタルイミド (9. 57 g, 収率:62.5%)を得た。

76 * [0153] NMR (CDC13) 6:3.01 (2 H. s), 3. 62 (2 H, m), 3. 86 (2 H, m), 5. 05 (2H, m), 7. 37 (2H, d, J = 8. 37 Hz), 7. 73 (2 H. m), 8. 10 3 d) [0154] 【作53]

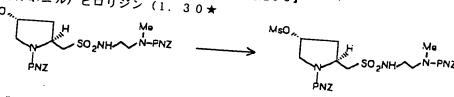
上記反応で得られた化合物 (5.75g,15mmo l)、ヒドラジン・1水和物(1.82m1,37.5 mmo l) のメタノールーテトラヒドロ フラン (1: 1;200ml) 溶液を室温で1.5時間撹拌した後、 更にヒドラジン・1 水和物 (0. 73 ml, 15 mmo 1)を加え、60℃で3時間撹拌した。析出結晶を濾別 し、濾液を濃縮した。残渣に酢酸エチルを加え、この溶 液を8%アンモニア水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水 硫酸ナトリウムで脱水、濃縮し、油状の2~ [N-メテ ルーN-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)アミ※



(2S, 4R) -4-ヒドロキシ-N- (4-ニトロベ ンジルオキシカルポニル)-2-チオシアノメチルピロ リジン(3、37g、10mmol)、2-{N-メチ ルーN- (4 -ニトロペンジルオキシカルボニル)アミ ノ] エテルアミン (2. 53g, 10mmol) および トリエチルアミン(2.79ml.20mmol)を用 いて、参考例1g)と同様の反応を行い、(2S,4 R) -4-ヒドロキシ-2- [N-[2-[N-メチル - N - (4 - ニトロペンジルオキシカル ポニル)アミ ノ] エチル] スルファモイルメチル] -N-(4-二ト ロベンジルオキシカルボニル) ピロリジン (1. 30★



[0158] 【化55]



上記反応で得られた化合物 (1.30g, 2.23mm ○ l) 、メタンスルホニルクロリド(O. 2 l m l . 2. 68mmol) およびトリエチルアミン (0. 47 m I、 3. 3 5 m m o l)を用いて、参考例 l h)と同 様の反応を行い、 (2 S. 4 R) - 4 - メタンスルホニ ルオキシー2 - [N-[2-[N-メチル-N-(4=50

ニトロペンジルオキシカルボニル) アミノ] エチル] ス ルファモイルメテル] -N- (4-ニトロペンジルオキ シカルポニル) ピロリジン (1. 45g. 収率:98.

NMR (CDC11) 6:2.37 (1H, m).2. 70 (1 H. m). 3. 02~3. 07 (6 H. d).

※ノ] エチルアミン (3. 23g. 収率:85%) を得

[0155] NMR (CDC11) 6:2.86 (2 H, t, J = 6.62 Hz), 2.97 (3H, s). 3. 3.5 (2 H, t, J = 6. 3.5 Hz), 5. 20 (2 H. s). 7. 50 (2 H. d, J=8.64 H)z), 8. 20 (2H, d, J=8. 64Hz) [0156]

3. 33~3. 83 (6H, m), 4. 05~4. 39 *3g) (3H, m), 5. 23 (5H, s), 7. 50 (4 [0159] H, m), 8. 21 (4H, d, J=8. 37Hz) * 【化56】

[0 1 6 0] NMR (CDC 1₃) δ : 2. 1 0 (1 H. m), 2. 3 5 (3 H. s), 2. 7 0 (1 H. m), 3. 0 2 (3 H. s), 3. 0 9 ~ 3. 5 2 (6 \times 20

%H, m), 3. 79~4. 28 (3H, m), 5. 21
10 (5H, m), 7. 52 (4H, d, J = 7. 6H
z), 8. 20 (4H, m)

参考例 4

(2 S. 4 S) - 4 - アセチルチオ-N- (4 - 二トロベンジルオキシカルボニル) - 2 - [4 - (4 - 二トロベンジルオキシカルボニル) - 1 - ピペラジニルスルホニルメテル] ピロリジン

4 a) 【0 1 6 1】 【化5 7】

(2S, 4R) -4-tert-ブチルジメチルシロキシーN-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-2-チオシアノメチルピロリジン(4g, 8.86 mmol)、N-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)ピペラジン(2.35g, 8.86 mmol)およびトリエチルアミン(2.47 ml,17.7 mmol)を用いて、参考例1g)と同様の反応を行い、(2S,4R)-4-ヒドロキシーN-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-2-[4-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-1-ピペラジニルスルホニルメチル]ピロリジン(1.33g,収率:24.7%)を得た。★

* [0 1 6 2] NMR (CDCl₃) δ : 2. 2 5 (1 H, m), 2. 4 (1 H, m), 3. 0 (1 H, m), 3. 3 (4 H, br s), 3. 4 ~ 3. 7 (6 H, m), 3. 8 5 (1 H, d, J=12 Hz), 4. 3 5 (1 H, m), 4. 5 (1 H, m), 5. 2 (4 H, s), 7. 5 1 (4 H, d, J=8. 9 Hz), 8. 2 3 (2 H, d, J=8. 9 Hz), 8. 3 5 (2 H, d, J=8. 9 Hz)

40) [0163]

3g, 収率: 24. 7%) を得た。 ★ 【化58】

MsO

PNZ

N-PNZ

N-PNZ

N-PNZ

上記反応で得られた化合物(1.33g, 2.19mm o l)、メタンスルホニルクロリド(0.36 m l, 4.66 m m o l) およびトリエチルアミン(0.72 m l, 5.16 m m o l) を用いて、参考例 l h) と同様の反応を行い、(2 S.4 R) -4-メタンスルホニルオキシ-N-(4-ニトロペンジルオキシカルポニル) -2-[4-(4-ニトロペンジルオキシカルポニル) -1-ピペラジニルスルホニルメチル] ピロリジン(1.08g,収率:72%)を得た。

[0164] NMR (CDCl₁) δ : 2. 4 (1 H. m). 2. 7 (1 H. m). 3. 0 5 (3 H. s). 3. 1 (1 H. m). 3. 3 (4 H. brs). 3. 5 \sim 3. 8 (6 H. m). 4. 0 5 (1 H. d. J = 1 2. 9 Hz). 4. 4 (1 H. m). 5. 2 4 (5 H. s). 7. 51 (4 H. d. J = 8. 9 Hz). 8. 2 4 (4 H. d. J = 8. 9 Hz) 4 c)

50 [0165]

【化59]

上記反応で得られた化合物(1.08g, 1.58mm ol)、チオ酢酸カリウム(460mg, 4mmol) およびよう化ナトリウム(233mg, 1.55mmol)を用いて、参考例1i)と同様の反応を行い、(2 ジルオキシカルボニル)-2-[4-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル)-1-ピペラジニルスルホニルメチル] ピロリジン(900mg, 収率:85.8%)を得た。

[0166] NMR (CDC11) 6:2.2 (1H. m), 2.35 (3H. s), 2.7 (1H. m).

3. 0~3. 2 (2 H, m), 3. 3 (4 H, m), 3. 6 (4 H, m), 3. 8~4. 1 (3 H, m), 4. 25 (1 H, m), 5. 21 (2 H, s), 5. 2 10 4 (2 H, s), 7. 5 (4 H, d, J=8 Hz), 10 16 7]

【発明の効果】本発明の化合物は、文献未記載の新規化合物であり、感受性・耐性のグラム陽性菌およびグラム陰性菌に対する強い抗菌力、β-ラクタマーゼおよびDHP-Iに対する優れた安定性を有するので、抗菌剤として有用である。

フロントページの統き

(72)発明者 牛鳴 良輔

愛知県岡崎市上六名3丁目9番地1 萬有 製薬株式会社岡崎研究所内